

WPIINDEX	Derwent World Patent Index® Standard File
WPIDS	Derwent World Patent Index® Subscriber File
WPIX	Derwent World Patent Index® Subscriber File with Extension Abstract * WPIDS/WPIX ファイルは会員用ファイルです。非会員の方は WPIINDEX ファイルをご利用ください
収録範囲	特許取得可能なすべての科学技術分野。主題分野別の収録開始年は以下の通り。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬：1963年</li> <li>・農薬：1965年</li> <li>・プラスチック、ポリマー：1966年</li> <li>・その他の化学一般分野：1970年</li> <li>・機械、電気、一般技術：1974年</li> </ul>
ファイル種類	書誌データベース
特徴	<p>各種シソーラス：国際特許分類 (/IPC)、共通特許分類 (/CPC)、ヨーロッパ特許分類 (/EPC、/ICO)、米国特許分類 (/NCL)、FI (/FCL)、F ターム (/FTERM)、マニュアルコード (/MC)、新ポリマー索引 (/PLE)、タイトルターム (/TT)。</p> <p>以下のフィールドは、オンラインシソーラスと同様の機能が利用可能です。ダウエント化合物番号 (/DCN)、ダウエント登録番号 (/DRN)、特許出願人コード (/PACO)、プラスドックキーシリアル番号 (/KS)</p> <p>アラート (自動 SDI 検索) 毎月、毎週、更新ごと (週に 2 回、デフォルト)</p> <p>CAS RN® (CAS 登録番号) <input type="checkbox"/> 中間一致・<input checked="" type="checkbox"/> 後方一致検索</p> <p>Keep &amp; Share <input checked="" type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/></p>
レコード内容	<p>&lt;文献レコード&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各レコードで利用可能な対応特許情報 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ベーシック特許</li> <li>- 対応特許 (他国で発行された同一発明に関する特許)</li> </ul> </li> <li>・発明レベル：書誌情報、Clarivate Analytics が作成した標題、抄録、一般的な索引、および化学分野と電気分野の詳細な索引、電気分野およびエンジニアリング分野の図面、化学構造図を収録。</li> <li>・公報レベル：特許ファミリーを構成する個々の公報の書誌情報と著者標題・抄録、クレーム、住所を含む代理人情報、特許出願人情報を収録。それぞれの公報レベルに限定した検索も可能。</li> <li>・クレーム情報は 20 以上の特許発行国について収録しています。</li> <li>・DPCI (Derwent Patent Citation Index) がこのファイルに完全に統合され、32 の特許発行国に関する引用特許・被引用特許だけでなく、引用文献も収録。</li> <li>・会員のレベルによって、使用できるファイル・機能が異なります。WPIDS ファイルでは会員用コード (/DEN、/DRN、/PLE、/KS など) が利用可能。WPIX ファイルでは、会員用コードおよび、詳細な発明内容を記述する拡張抄録フィールド (ABEX)、ドキュメンテーション抄録 (ABDT) が利用可能。</li> <li>・59 の物理学的・化学的物性値が、英文テキストフィールド (標題、抄録、クレーム) で検索可能です。</li> </ul>

北アメリカ  
CAS  
STN North America  
P. O. Box 3012  
Columbus, Ohio 43210-0012 U. S. A.  
CAS Customer Center:  
Phone: 800-753-4227 (North America)  
614-447-3731 (worldwide)  
E-mail: help@cas.org  
Internet: www.cas.org

ヨーロッパ  
CAS Customer Center EMEA  
(represented by FIZ Karlsruhe)  
P. O. Box 2465  
76012 Karlsruhe  
Germany  
Phone: +49-7247-808-555  
E-mail: EMEAhelp@cas.org

日本  
化学情報協会 (JAICI)  
STN Japan  
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4中居ビル  
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)  
0120-151-462 (上記以外)  
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)  
customer@jaici.or.jp (上記以外)  
Internet: www.jaici.or.jp

レコード数	52,000,000 件以上のレコード (2022 年 4 月現在)	
収録年代	1963 年以降 電気分野およびエンジニアリング分野の図面 : 1988 年以降 化学構造図 : 1988 年以降	
更新頻度	週 2 回更新	1 回の更新で約 47,000 件のベーシック特許, 約 66,000 件の対応特許、ポリマーおよびケミカルコードを追加 約 43,000 件の図面/化学構造図を追加
言語	英語	
データベース	Clarivate	
製作者	Friars House, 160 Blackfriars Rd. London SE1 8EZ United Kingdom Copyright Holder: Clarivate	
収録源	59 特許発行国 :	
	アルゼンチン (1975 年, 2015 年以降)	カザフスタン (2002 年以降)*
	アルメニア (2002 年以降)	キルギス (2002 年以降)*
	オーストラリア (1963-1969 年, 1983 年以降)	韓国 (1986 年以降)
	オーストリア (1975 年以降)	ルクセンブルグ (1984 年以降)
	ベラルーシ (2002 年以降)	メキシコ (1997 年以降)
	ベルギー (1963 年以降)	マレーシア (2005 年以降)
	ブラジル (1976 年以降)	モルドバ (2002 年以降)*
	カナダ (1963 年以降)	オランダ (1963 年以降)
	中国 (1987 年以降)	ニュージーランド (1993 年以降)
	チェコ (1994 年以降)	ノルウェー (1974 年以降)
	チェコスロバキア (1975-1994 年)	PCT (WIPO) (1978 年以降)
	デンマーク (1974 年以降)	フィリピン (1994 年以降)
	ユーラシア特許 (2002 年以降)*	ポーランド (2011 年以降)
	EPO (1978 年以降)	ポルトガル (1974 年以降)
	フィンランド (1974 年以降)	ルーマニア (1975 年以降)
	フランス (1963 年以降)	ロシア (1994 年以降)
	ジョージア (2002 年以降)*	シンガポール (1995 年以降)
	ドイツ (1963 年以降)	スロバキア (1994 年以降)
	ドイツの実用新案 (1995 年以降)	南アフリカ (1963 年以降)
	旧東ドイツ (1963 年-1990 年まで)	旧ソ連 (1963 年-1994 年)
	湾岸協力会議 (GC) (2011 年以降)	スペイン (1983 年以降)
	香港 (2011 年以降)	スウェーデン (1974 年以降)
	ハンガリー (1975 年以降)	スイス (1963 年以降)
	インド (2004 年以降)	タイ (2010 年以降)
	インドネシア (2010 年以降)	タジキスタン (2002 年以降)*
	アイルランド (1963-1969 年, 1995 年以降)	台湾 (1993 年以降)
	イスラエル (1975 年以降)	トルコ (2015 年以降)
	イタリア (1966-69 年, 1978 年以降)	イギリス (1963 年以降)
	日本 (1963 年以降)	アメリカ (1963 年以降)
	・その他の収録源	ウズベキスタン (2002 年以降)*
	- Research Disclosure 誌 (1978 年以降)	ベトナム (2010 年以降)
	- International Technology Disclosures 誌 (1984-1993 年)	

収録に関する詳細は Clarivate の以下のサイトで確認できます。

<https://clarivate.com/products/dwpi-reference-center/dwpi-coverage/>

収録源 (続き)	<p>DPCI (Derwent Patent Citation Index) がこのファイルに完全に統合され、32 の特許権に関する引用文献だけでなく、引用特許・被引用特許も収録しています。</p> <p>公報の著者標題、抄録、クレーム、発明者、特許出願人、代理人、住所情報は公報レベルに含まれます。</p> <p><a href="https://www.stn-international.com/en/training-center/recorded-e-seminars/derwent-world-patents-index-database-stn-overview-value-added">https://www.stn-international.com/en/training-center/recorded-e-seminars/derwent-world-patents-index-database-stn-overview-value-added</a></p> <p>クレーム情報は 20 以上の特許発行国について収録しています。</p>
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPI ファイルの資料 <a href="https://www.jaici.or.jp/stn-ip-protection-suite/cas-stnext/documents/#03">https://www.jaici.or.jp/stn-ip-protection-suite/cas-stnext/documents/#03</a></li> <li>• オンラインヘルプ =&gt; <a href="#">HELP DIRECTORY</a> ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます。</li> <li>• STNGUIDE ファイル</li> <li>• 以下の資料は、Clarivate Analytics より入手可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patent Sources</li> <li>- Introduction to Chemical Indexing</li> <li>- Classification User Guide</li> <li>- Title Terms User Guide</li> <li>- Patentee Codes User Guide</li> <li>- CPI Chemical Indexing Guidelines, Indexing of Chemical and Pharmaceutical Patents</li> <li>- CPI Chemical Indexing User Guide</li> <li>- CPI Manual Codes User Guide</li> <li>- Chemistry Resource on STN</li> <li>- CPI Plasdoc Coding Systems User Guide</li> <li>- Polymer Indexing Directory Parts 1 and 2</li> <li>- Polymer Indexing Reference Manual</li> <li>- Polymer Indexing System Description User Guide</li> <li>- Polymer Indexing Thesaurus Guide</li> <li>- Polymer Indexing Hierarchy User Guide</li> <li>- EPI Manual Codes User Guide Parts 1, 2 and 3</li> </ul> </li> <li>• 以下の資料は、STN ホームページより入手可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reference Information for the Derwent World Patent Index <a href="https://www.stn-international.com/resources/reference-information-derwent-world-patents-index">https://www.stn-international.com/resources/reference-information-derwent-world-patents-index</a></li> </ul> </li> </ul>
利用可能な クラスター	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• AEROTECH</li> <li style="width: 50%;">• ENGINEERING</li> <li style="width: 50%;">• ALLBIB</li> <li style="width: 50%;">• FORMULATIONS</li> <li style="width: 50%;">• AUTHORS</li> <li style="width: 50%;">• PATENTS (HPATENTS)</li> <li style="width: 50%;">• BIOSCIENCE</li> <li style="width: 50%;">• POLYMERS</li> <li style="width: 50%;">• CORPSOURCE</li> </ul>
関連データ ベース	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DWPIM ファイル : WPI ファイル由来のマルクージュ構造を収録するデータベースです。</li> <li>• DCR ファイル : WPI ファイル由来の特定化学物質を収録するデータベースです。</li> </ul>

## 発明レベル

## 検索フィールド

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク (\*) で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
なし または /BI, /BIX	基本索引 * 標題 (/TI) タイトルターム (/TT) 追加語 (AW) 拡張抄録 (/ABEX) ドキュメンテーション抄録 (/ABDT) 抄録 (/AB) <sup>1)</sup> Alerting Abstract, First Section (/ALE) Novelty (/NOV) Detailed Description (/DETD) Mechanism of Action (/ACTN) Activity (/ACTV) Advantage (/ADV) Use/Advantage (/UADV) Use (/USE) Drawing Description (/DRWD) 対応特許抄録 (ABEQ) Technology Focus (/TECH) (以上からの切出し語) <sup>18)</sup>	S DRILLING FLUID AND EMULS? S ?PHENYLETHER? S #####DIPHENYLETHER S ULCER TREATMENT(L) ORAL	AB, ABDT, ABEQ, ABEX, ACTN, ACTV, ADV, ALE, DETD, DRWD, NOV, TECH, TI, TT, UADV USE
/AB /ABDT  /ABDT. ACTN  /ABDT. ACTV  /ABDT. ADM  /ABDT. ADV  /ABDT. BIO  /ABDT. CLM  /ABDT. DEF  /ABDT. DES  /ABDT. DOS  /ABDT. DRWD  /ABDT. EMB	抄録 <sup>18)</sup> * ドキュメンテーション抄録* <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Mechanism of Action * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Activity * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Administration * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Advantage * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Biology * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Claimed * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Definition * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Description * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Dosage * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Drawing Description * <sup>1, 18)</sup> ドキュメンテーション抄録, Embodiment * <sup>1, 18)</sup>	S OSTEOGENIC PROTEIN/AB S (DNA AND PROTEIN)/ABDT  S CELL?/ABDT. ACTN  S AGONIST?/ABDT. ACTV  S ORAL/ABDT. ADM  S (STRENGTH AND (INCREAS? OR RIS? OR GAIN?))/ABDT. ADV S (LEUKAEM? AND CELL?)/ABDT. BIO  S KETON?/ABDT. CLM  S CYCL?/ABDT. DEF  S ARYL?/ABDT. DES  S (SPRAY? OR AEROSOL OR DUST? OR POWDER? OR GRANUL?)/ABDT. DOS S FILTER?/ABDT. DRWD  S (POLYMER AND RESIN?)/ABDT. EMB	AB ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT  ABDT

(続く)

## 検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/ABDT. EX	ドキュメンテーション抄録, Example * <sup>1,18)</sup>	S BIODEGRAD?/ABDT. EX	ABDT
/ABDT. FS	ドキュメンテーション抄録, First Section * <sup>1,18)</sup>	S NYLON/ABDT. FS	ABDT
/ABDT. GEN	ドキュメンテーション抄録, General * <sup>1,18)</sup>	S RARE EARTH/ABDT. GEN	ABDT
/ABDT. INO	ドキュメンテーション抄録, Inorganic Chemistry * <sup>1,18)</sup>	S (FIBER OR RESIN)/ABDT. INO	ABDT
/ABDT. MAT	ドキュメンテーション抄録, Specific Materials * <sup>1,18)</sup>	S VINYL?/ABDT. MAT	ABDT
/ABDT. MS	ドキュメンテーション抄録, More Specifically * <sup>1,18)</sup>	S (F OR CI)/ABDT. MS	ABDT
/ABDT. NOV	ドキュメンテーション抄録, Novelty * <sup>1,18)</sup>	S (SHEET OR FABRIC)/ABDT. NOV	ABDT
/ABDT. ORG	ドキュメンテーション抄録, Organic Chemistry * <sup>1,18)</sup>	S TETRAHYDROFURAN/ABDT. ORG	ABDT
/ABDT. PRE	ドキュメンテーション抄録, Preferred * <sup>1,18)</sup>	S BUTYROLACTON?/ABDT. PRE	ABDT
/ABDT. PRP	ドキュメンテーション抄録, Preparation * <sup>1,18)</sup>	S IMIDAZOL?/ABDT. PRP	ABDT
/ABDT. SUB	ドキュメンテーション抄録, Specific Compounds * <sup>1,18)</sup>	S MALEIC/ABDT. SUB	ABDT
/ABDT. TECH	ドキュメンテーション抄録, Technology Focus * <sup>1,18)</sup>	S (LAYER? OR COAT?)/ABDT. TECH	ABDT
/ABDT. UADV	ドキュメンテーション抄録, Use/Advantage * <sup>1,18)</sup>	S (TAST? OR EAT?)/ABDT. UADV	ABDT
/ABDT. USE	ドキュメンテーション抄録, Use * <sup>1,18)</sup>	S ((DERM? OR SKIN?) AND AGE?)/ABDT. USE	ABDT
/ABDT. WD	ドキュメンテーション抄録, Wider Disclosure * <sup>1,18)</sup>	S BLOOD?/ABDT. WD	ABDT
/ABEX	拡張抄録 * <sup>2,18)</sup>	S ?FERMENT?/ABEX	ABEX
/ABEX. ADM	拡張抄録, Administration * <sup>2)</sup>	S BUCCAL(P)DOS?/ABEX. ADM	ABEX
/ABEX. DEF	拡張抄録, Definition * <sup>2)</sup>	S ?ALKYL?/ABEX. DEF	ABEX
/ABEX. EX	拡張抄録, Example * <sup>2)</sup>	S (NUC? AND COMPLEX?)/ABEX. EX	ABEX
/ABEX. PRI	拡張抄録, Priority * <sup>2)</sup>	S METABOLIC/ABEX. PRI	ABEX
/ABEX. SC	拡張抄録, Specific Compounds * <sup>2)</sup>	S ?NITRO?/ABEX. SC	ABEX
/ABEX. WD	拡張抄録, Wider Disclosure * <sup>2)</sup>	S KINASE?/ABEX. WD	ABEX
/AC	出願国 <sup>3)</sup>	S GB/AC(P)1999/AY	ADT, AI
/AC. B	ベーシック特許の出願国	S AU/AC. B	HITMEMB
/ACTN	Mechanism of Action *	S KINASE INHIBITOR?/ACTN	ACTN, AB
/ACTV	Activity * <sup>18)</sup>	S ANTIBIOTIC ACTIVITY/ACTV	ADT, AI
/AD	出願日 <sup>3), 4)</sup>	S JAN 1993-APR 1993/AD(P)FR/AC S 19930101-19930430/AD(P)FR/AC	ADT, AI
/AD. B	ベーシック特許の出願日 <sup>3), 4)</sup>	S US/AC. B(P)OCT 2015/AD. B	HITMEMB
/ADV	Advantage * <sup>18)</sup>	S LASER BEAM?/ADV	ADV, AB
/AN	レコード番号	S 2008-B12345/AN	AN
/DW. AN	レコード番号週、補足	S 196800/DW. AN	AN
/ANX	クロスオーバーレコード番号	S 1980-B7362C/ANX	ANX, CR
/ALE	Alerting Abstract, First Section * <sup>18)</sup>	S (CATALY?(2A)REDUC?)/ALE	ALE, ABS
/AP	出願番号 <sup>3,5)</sup>	S GB1989-219641/AP	ADT, AI
/AP. B	ベーシック特許の出願番号 <sup>3,5)</sup>	S KR2019-100030/AP. B	HITMEMB
/AP. YR	出願番号, 年 <sup>4)</sup>	S 2004/AP. YR	ADT, AI
/APT	出願タイプ	S RELATED TO/APT	ADT, AI

(続き)

## 検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/AY	出願年 <sup>3),4)</sup>	S 2004-2005/AY	ADT, AI
/AY. B	ベーシック特許出願年 <sup>3),4)</sup>	S 2017-2020/AY. B	HITMEMB
/CPC	共通特許分類	S D03D0015-0011/CPC	CPC
/CPC. ACD	共通特許分類, 発行日 <sup>4)</sup>	S 20130101/CPC. ACD	CPC. TAB
/CPC. CS	共通特許分類, コンビネーション セット	S A61K0039-42/CPC. CS	CPC, CPC. TAB
/CPC. KW	共通特許分類, キーワード	S INVENTION/CPC. KW	CPC. TAB
/CPC. VER	共通特許分類, 版	S 20130101/CPC. VER	CPC. TAB
/CR	クロスリファレンス	S 1990-001459/CR	CR, XR
または /XR			
/CYC	特許発行国数 <sup>4)</sup>	S 20-30/CYC	CYC
/DC	ダウメントクラス <sup>7)</sup>	S A25/DC	DC
/DCN	ダウメント化合物番号	S DCN-R00001/DCN S R00001/DCN	DCN
/DCR	DCR番号	S DCR-1911/DCR S 1911/DCR	IT, CMC
/DCRU	未リンクDCR番号	S DCR-1/DCRU	DCRU, CMC
/DETD	Detailed Description * <sup>18)</sup>	S NAPHTHALENE?/DETD	DETD, AB
/DLVL	ドキュメントレベル	S L1 (L) INVENTION/DLVL	表示されない
/DNC	第二次アクセス番号 CPI	S C1993-056092/DNC	DNC
/DNN	第二次アクセス番号 CPI 以外	S N1983-041984/DNN	DNN
/DRN	ダウメント登録番号 <sup>22)</sup>	S DRN-0001/DRN S 0001/DRN	DRN
/DRWD	Drawing Description <sup>18)</sup> *	S ?TANGUL?/DRWD	DRWD, AB
/DRWN	図面の数 <sup>4)</sup>	S DRWN=9	DRWN, PI
/DS	指定国 <sup>6)</sup>	S BE/DS(P) 1999/PY	DS, PI
/DT	資料種類 (コードおよび資料名)	S L7 AND P/DT S L7 AND UTILITY MODEL/DT	表示されない
/DUPD	Clarivate Analytics アップデート (入力時の DW と 最新の DW) <sup>4)</sup>	S 197007/DUPD	DUPD
/DW	ダウメントアップデート <sup>4),6)</sup>	S 199908/DW S 199901-199915/DW(P)FR/PC	PI
/DW. B	ダウメントアップデート, Basic 特許 <sup>4),6)</sup>	S 199915/DW. B(P)US/PC. B	PI. B, PI
/ED	入力日 <sup>4)</sup>	S ED>20060210 AND L10	ED
/EPC (/ECLA, /EPCLA)	ヨーロッパ特許分類 <sup>8)</sup>	S A01B0015-20/EPC	EPC, ECLA, EPCLA
/FA	フィールドの存在	S L7 NOT NOAB/FA S L11 AND GI/FA	FA

(続く)

## 検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/FACL /FCL /FDT	FI (追加分類) FI 出願経過の詳細 <sup>5), 6)</sup>	S A61K0008-19/FACL S A61K0006-00 A/FCL S US5072794/FDT S EP----105613/FDT	FCL FCL FDT
/FDT.PC /FDT.PK または /RLPK /FDT.PN または /RLPN /FDT.TP /FG (/AM)	出願経過の詳細, 特許発行国 出願経過の詳細, 特許種別コード 出願経過の詳細, 特許番号 出願経過の詳細, 出願タイプ フラグメンテーションコード <sup>19), 20), 22)</sup>	S AUSTRIA/FDT.PC S CZA/FDT.PK S CA1248729/FDT.PN S REISSUE OF/FDT.TP S (012(P)032(P)046)/FG	FDT FDT FDT FDT FG, PLC
/FICL /FMCL /FSCL /FS /FTRM (/FTERM, /FTCLA, /JPCLA) /IC	FI (インデキシング) FI (主分類) FI (副分類) ファイルセグメント F ターム <sup>8)</sup>  国際特許分類 (IPC1-7) (主分類および副分類)	S A61K0035-12/FICL S D21C0009-10/FMCL S G01B0003-10 101/FSCL S PLASMA AND EPI/FS S 5B001/AA01/FTRM  S C09K007/IC S C09K007-02/IC S C09K-007-02/IC S D01D005-08?/IC	FCL FCL FCL FS FTRM  IC, IPC
/ICA	国際特許分類, 追加分類 (参考情報記号) (IPC1-7)	S A01K067-027/ICA	ICA
/ICI	国際特許分類, インデキシング コード (相補情報記号) (IPC1-7)	S B03D0103:04/ICI	ICI
/ICM	国際特許分類, 主分類 (IPC1-7)	S C09K007-02/ICM	ICM
/ICO	コンピュータ分類 (EP0) <sup>8)</sup>	S K61M/ICO	ICO
/ICS	国際特許分類, 副分類 (IPC1-7)	S D01B001-04/ICS	ICS
/IN または /AU	発明者名	S HALE, A H/IN S HALE A H/IN, PA	IN
/IT または /KW	索引 (Index Term)	S DCR-168/IT S 168/IT	IT
/IPC	国際特許分類, 全 IPC <sup>8)</sup> (ICA, ICI, ICM, ICS, IPCI, IPCR, IICM, IICS, IICA, IICI)	S C12P0021-08/IPC S C12!/IPC S C12P0021/IPC	IPC
/IPC.ACD	国際特許分類, 発行日 <sup>4)</sup>	S IPC.ACD>20070107	IPC.TAB
/IPC.F	国際特許分類, 第一分類	S A61K0008-63/IPC.F	HIT, IPC.TAB
/IPC.KW	国際特許分類, キーワード	S ADDITIONAL/IPC.KW	IPC.TAB
/IPC.REF	国際特許分類, リフォーム	S A01B0003-44/IPC.REF	IPCI, IPCR
/IPC.VER /LA	国際特許分類, 版 <sup>4)</sup> 言語 (コードおよびテキスト)	S 20080101/IPC.VER S FR/LA (P) EP/PC S FRENCH/LA (P) EP/PC (P) 1999/PY	IPC.TAB PI
/M0 - /M6	ケミカルコード <sup>19), 22)</sup>	S (D711 (P) F431 (P) H522) /M2, M3, M4	CMC
/MC	マニュアルコード <sup>8), 9), 23)</sup>	S X11-A01A1/MC	MC
/MCN	マルクーシュ化合物番号	S 0153-12201-CL/MCN	MCN, CMC

(続く)

## 検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/NCL	米国特許分類 <sup>8)</sup>	S 002006700/NCL	NCL
/NCLM	米国特許分類, 主分類	S 002/NCLM	NCL
/NCLS	米国特許分類, 副分類	S 004/NCLS	NCL
/NOV	Novelty <sup>11), 18)</sup> *	S EXCITATION LIGHT/NOV	NOV, AB
/PA	特許出願人 <sup>10)</sup>	S SHELL OIL/PA	PA
または /CS		S "NEW YORK WIRE"?/PA	
/PACO	特許出願人コード <sup>8), 12)</sup>	S SHEL/PACO	PA
/PC	特許発行国 <sup>6), 13)</sup> (コードおよび国名)	S GB/PC (P) 1999/AY	PI
/PC. B	特許発行国, Basic 特許 <sup>6), 13)</sup>	S UNITED KINGDOM/PC	
/PD	発行日 <sup>4), 6)</sup>	S GB/PC. B (P) JUNE 1992/PD. B	PI. B, PI
/PD. B	発行日, Basic 特許 <sup>4), 6)</sup>	S 19900404/PD	PI
/PGN	ページ数 <sup>4)</sup>	S 1 APR 1999-15 APR 1999/PD (P) GB/PC	PI. B, PI
/PK	特許種別コード <sup>6), 14)</sup>	S 19930330/PD. B (P) US/PC. B	PI
/PK. B	特許種別コード, Basic 特許 <sup>6), 14)</sup>	S PGN=5	PI
/PLE	新ポリマー索引 <sup>21), 22)</sup>	S HU?/PK	PI
/PN	特許番号 <sup>5), 6)</sup>	S EPA2/PK (P) DE/DS	
		S EPA?/PK. B	PI. B, PI
		S EPA1/PK. B (P) 1991-1992/PY. B	
		S (R01737 (P) C088) /PLE	PLE
		S US5198416/PN	PI
		S EP-----100323/PN	
		S EP0100323/PN	
		S EP100323/PN	
		S US20060000001/PN	
		S US-20060000001/PN	
/PN. B	特許番号, Basic 特許 <sup>5), 6)</sup>	S US5198416/PN. B	PI. B, PI
/PNC	特許番号数 <sup>4)</sup>	S 5-10/PNC	PNC
/PNK	種別付き特許番号	S W02009006253A2/PNK	PNK
/PNK. B	種別付き特許番号, Basic 特許	S TH43458A/PNK. B	PNK. B
/PRC	優先権主張国 <sup>15)</sup>	S FR/PRC	PRAI
/PRCF	最先の優先権主張国	S GB/PRC (S) 1990/PRY	
/PRD	優先権主張日 <sup>4), 15)</sup>	S AU/PRCF	PRAI
		S 20010930/PRD	PRAI
		S JUNE 1991/PRD (S) FR/PRC	
/PRDF	最先の優先権主張日 <sup>4), 15)</sup>	S JUNE 2002/PRDF	PRAI
/PRN	優先権出願番号 <sup>5), 15)</sup>	S 1988US-000252206/PRN	PRAI
		S US1988-252206/PRN	
/PRN. YR	優先権出願番号, 年 <sup>4)</sup>	S 2005/PRN. YR	PRAI
/PRNF	最先の優先権出願番号	S AL 1961-8036/PRNF	PRAI
/PRY	優先権主張年 <sup>4), 15)</sup>	S 1990-1991/PRY (S) NL/PRC	PRAI
/PRYF	最先の優先権主張年, <sup>4), 15)</sup>	S 1992/PRYF	PRAI
/PT	特許タイプ	S EQUIVALENT/PT AND BE/PC	PI
/KS	プラスドックキーシリアル <sup>19), 20), 21), 22)</sup>	S 0004 0003/KS	KS, PLC
/PY	発行年 <sup>4), 6)</sup>	S 1998-1999/PY	PI
/PY. B	発行年, Basic 特許 <sup>4), 6)</sup>	S 1998/PY. B (P) JP/PC. B	PI. B, PI



## 検索フィールド (続き)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/RIN	環索引番号 <sup>22)</sup>	S RIN-00012/RIN	RIN, CMC
/RINU	非連鎖環索引番号 <sup>22)</sup>	S RIN-00044/RINU	RINU, RIN, CMC
/RL	ロール <sup>20)</sup>	S DCR-1/DCR(T) (P OR PRD)/RL	IT, CMC
/TECH	Technology Focus <sup>11), 18)</sup> *	S DYEING AGENT#/TECH	TECH
/TI	標題 <sup>18)</sup> *	S DRILLING FLUID#/TI	TI
/TT	タイトルターム <sup>16), 18)</sup> (追加語 (AW) を含む)	S DRILL FLUID/TT S FIBRE-OPTIC/TT	TT
/UADV	Use/Advantage <sup>18)</sup> *	S TREATMENT/UADV	UADV, AB
/UP	更新日 <sup>4)</sup>	S L7 AND 20061001-20061031/UP	UP
/UPA	ポリマー索引の更新日 <sup>4)</sup>	S UPA=APR 2005	UPA
/UPAB	抄録の更新日 <sup>4)</sup>	S MAR 2006-JUN 2006/UPAB AND L10	UPAB
/UPB	ケミカルコードの更新日 <sup>4), 22)</sup>	S UPB=APR 2005	UPB
/UPCP	CPCの更新日	S JAN 2021-JUNE 2021/UPCP	UPCP
/UPFT	FI, Fタームの更新日 <sup>4)</sup>	S UPFT>20210621	UPFT
/UPIC	国際特許分類の更新日 <sup>4)</sup>	S 20191227/UPIC	UPIC
/UPIN	発明者の更新日 <sup>4)</sup>	S UPIN=3 MAY 2013	UPIN
/UPIT (/UPKW)	索引の更新日 <sup>4)</sup>	S 20050412/UPIT (/UPKW)	UPIT
/UPMC	マニュアルコードの更新日 <sup>4)</sup>	S 2021/UPMC	UPMC
/UPP	新規レコード入力日および 対応特許の更新日 <sup>4)</sup>	S FEB 2006-JUN 2006/UPP	UPP
/UPPA	特許出願人の更新日 <sup>4), 22)</sup>	S 20060426/UPPA AND L15	UPPA
/UPTI	標題の更新日 <sup>4)</sup>	S 20060323/UPTI AND L2	UPTI
/USE	Use <sup>18)</sup> *	S ?PHENYLETHER?/USE	USE

- このフィールドは WPIX ファイルのみで表示可能。1995-1999 年のみ可能
- このフィールドは WPIX ファイルのみで利用可能。ダウエントアップデート 199908 以降の更新分から利用可能
- 同一出願に由来する出願データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。
- 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。
- これらの番号はダウエント形式および STN 形式のどちらでも検索できます。
- 一つの特許の特許情報 (特許番号, 特許発行国, 特許種別のみ) と出願情報は (P) 演算子によってリンクして検索できます。
- ダウエントクラスはテキスト形式では EXPAND することはできませんが検索はできません。
- このフィールドではシソーラスが利用できます。
- DWPI マニュアルコードは検索時に自動的に各検索後とその定義をエコーします。
- このフィールドでは、(S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには引用符で囲んで検索します。
- ダウエントアップデート 199908 以降のデータに収録されています。
- 特許出願人コードのリストは Clarivate のホームページで確認可能
- => [HELP\\_COUNTRY](#) と入力すると、収録国の情報を表示できます。
- => [HELP\\_KIND](#) と入力すると特許種別コードのリストを表示できます。
- 同一出願に由来する優先権データをリンクして検索するときには (P) 演算子で検索します。
- RLは DCR-, MCN-, DRN, DCN-番号を含みます。番号とロールは (T) 演算子で検索します。
- このフィールドでは、優先語や非優先語 (USE, UF) などが EXPAND と SEARCH で利用できます。
- AND、IS、OF、THE、TOは、このフィールドでは索引されません。これらの語を検索後として利用すると (1W) 演算子で検索されます。
- スペースは (P) 演算子として検索されます。
- /FG と /KS は、DWPI 更新 199401 で廃止され、/PLE に置き換えられました。
- /PLEは、DWPI更新199332以降、/FGと/KSを置き換えて利用できます。この中で、3つのレベルのリンク (tightest - (S), middle - (P), widest - (L))。ポリマー索引はオンラインシソーラスが利用できます。
- WPIDS, WPIX ファイルでのみ利用可能なフィールドです。
- A-N のマニュアルコードはWPIDS, WPIX ファイルでのみ利用できます。

## スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索フィールドを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスファイルおよびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND は利用できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

スーパー検索フィールド	検索されたフィールド	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/APPS	/AP, /PRN	特許出願番号および 優先権出願番号 <sup>1)</sup>	S 1989GB-0219641/APPS S GB1989-219641/APPS	ADT, AI, PRAI
/DN	/DNC, /DNN	資料番号	S C1993-056092/DN	DNC, DNN
/MALL	/M0, /M1, /M2, /M3, /M4, /M5, /M6	ケミカルコード, 全てのサブフィールド	S A100/MALL	M0-M6, CMC
/PATS	/FDT, PN, /PN	特許番号グループ	S GB2223255/PATS S EP-100323/PATS	FDT, PI
/PCS	/DS, /PC	特許発行国および指定国 (コードおよび国名)	S ES/PCS S SPAIN/PCS	PI, DS, PN

1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

## 公報レベル

## 検索フィールド

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク (\*) で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/BIEX	拡張基本索引 <sup>2)</sup> * (公報レベルの著者標題, 著者抄録, クレーム)	S NANOCLUSTER#/BIEX	ABDE, ABEN, ABES, ABFR, ABOL, CLMEN, CLMDE, CLMFR, TIDE, TIEN, TIES, TIFR
/ABDE	抄録, オリジナル (ドイツ語) <sup>2)</sup> *	S ?AUTOMATISIERT?/ABDE	ABDE
/ABEN	抄録, オリジナル (英語) <sup>2)</sup> *	S ?CONDUCTIVE MATERIAL/ABEN	ABEN
/ABES	抄録, オリジナル (スペイン語) <sup>2)</sup> *	S AUTOMOVIL?/ABES	ABES
/ABFR	抄録, オリジナル (フランス語) <sup>2)</sup> *	S ?MOBILIS?/ABFR	ABFR
/ABOL	抄録, オリジナル (その他の言語) <sup>2)</sup> *	S ?MOLECUL?/ABOL	ABOL
/AG	代理人 <sup>3)</sup>	S PFIZER/AG	AG
/AG. T	代理人 (全データ) <sup>3)</sup>	S (PFIZER(W) INC)/AG. T	AG. T
/AGA	代理人住所 <sup>3)</sup>	S NEWCASTLE/AGA	AGA
/AG. CNY	代理人, 国 (コード)	S NL/AG. CNY	AGA
/AG. CTY	代理人, 市	S (MUNICH OR MUENCHEN)/AG. CTY	AGA
/AG. ST	代理人, 州	S NY/AG. ST	AGA
/AG. ZIP	代理人, 郵便番号	S 69134/AG. ZIP	AGA
/APTS	出願情報 (Clarivate)	S FR2005-3462/APTS	APTS
/CLM	クレーム <sup>2)</sup> *	S BUEROSTUHL/CLM	CLMEN, CLMDE, CLMFR, CLMES, CLMOL
		S PROCEDE DE TEINTURE/CLM	
		S ?CHAIR?/CLM	
/CLMDE	クレーム (ドイツ語) <sup>2)</sup>	S KATALYSATORSYSTEM?/CLMDE	CLMDE
/CLMEN	クレーム (英語) <sup>2)</sup>	S (CATALY?(2A)?REDUC?)/CLMEN	CLMEN
/CLMES	クレーム (スペイン語) <sup>2)</sup>	S (METODO(5A) CUALQUIERA)/CLMES	CLMES
/CLMFR	クレーム (フランス語) <sup>2)</sup>	S (CATALYS?(2A) MICROP?)/CLMFR	CLMFR
/CLMOL	クレーム (その他の言語) <sup>2)</sup>	S (EMULSAO(P) OLEO)/CLMOL	CLMOL
/FA. M	フィールドの存在 (公報レベル)	S ABDE/FA. M	FA. M
/IIC	国際特許分類, 発行時 (主分類, 副分類)	S A01B001/IIC	IIC
/IICA	国際特許分類, 発行時, 追加分類 (参考情報記号)	S A01B003-36/IICA	IICA
/IICI	国際特許分類, 発行時, インデキ シングコード (相補情報記号)	S B03D0103:08/IICI	IICI
/IICM	国際特許分類, 発行時, 主分類	S A61K038-48/IICM	IICM
/IICS	国際特許分類, 発行時, 副分類	S C07K014-01/IICS	IICS

(続く)

検索フィールド（公報レベル）（続き）

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/IN. CTY	発明者, 市	S WIEN/IN. CTY	INA
/IN. CNY	発明者, 国	S DE/IN. CNY	INA
/IN. NAT	発明者, 国籍 (WIPO コード)	S AT/IN. NAT	INA
/IN. RES	発明者, 所在地 (コード)	S BE/IN. RES	INA
/IN. ST	発明者, 州	S OH/IN. ST	INA
/IN. T	発明者 (全データ) <sup>3)</sup>	S BLAKE/IN. T	IN. T
/IN. ZIP	発明者, 郵便番号	S 69469/IN. ZIP	INA
/INA	発明者住所 <sup>3)</sup>	S HEIDELBERG/INA	INA
/INCL	米国特許分類, 発行時	S 208139000/INCL	INCL
/INCLM	米国特許分類, 発行時, 主分類	S 208139000/INCLM	INCL
/INCLS	米国特許分類, 発行時, 副分類	S 208/INCLS	INCL
/INO	発明者, オリジナル	S MAYER DALE J/INO	INO
/INO. SNM	発明者, 姓	S SCHEKINEN/INO. SNM	INO
/IPC	国際特許分類	S A01B003-36/IPC	IPC
/IPC. ACD	国際特許分類, 発行日	S 20060101/IPC. ACD	IPC. TAB. M
/PA. CNY	特許出願人住所, 国 (コード)	S BE/PA. CNY	PAA
/PA. CTY	特許出願人住所, 市	S MUNICH/PA. CTY	PAA
/PA. LIM	特許出願人, 国 (コード)	S DE/PA. LIM	HITMEMB
/PA. NAT	特許出願人, 国籍 (コード)	S BE/PA. NAT	HITMEMB
/PA. RES	特許出願人, 所在地 (コード)	S DE/PA. RES	HITMEMB
/PA. ST	特許出願人, 州	S OH/PA. ST	PAA
/PA. T	特許出願人 (全データ) <sup>3)</sup>	S BASF AG/PA. T	PA. T
/PA. ZIP	特許出願人, 郵便番号	S 69140/PA. ZIP	PAA
/PAA	特許出願人住所 <sup>3)</sup>	S MUENCHEN?/PAA	PAA
/PAO	特許出願人, オリジナル <sup>3)</sup>	S 3M COMPANY/PAO	PAO
/PRC. B	優先権主張国, Basic 特許 (コードおよびテキスト)	S AR/PRC. B	PRAI
/PRD. B	優先権主張日, Basic 特許 <sup>1)</sup>	S 19980101-19980301/PRD. B	PRAI
/PRN. B	優先権番号, Basic 特許	S AR1968-214388/PRN. B	PRAI
/PRTS	優先権情報 (Clarivate)	S 1977JP-000000061/PRTS	PRTS
/PRY. B	優先権主張年, Basic 特許 <sup>1)</sup>	S 1998/PRY. B	PRAI
/TIDE	原標題 (ドイツ語) <sup>2)</sup> *	S FRUCHTFLEISCH/TIDE	TIDE
/TIEN	原標題 (英語) <sup>2)</sup> *	S PLANT PRODUCT/TIEN	TIEN
/TIES	原標題 (スペイン語) <sup>2)</sup> *	S BIOLOGICO/TIES	TIES
/TIFR	原標題 (フランス語) <sup>2)</sup> *	S FRUIT##/TIFR	TIFR
/TIOL	原標題 (その他の言語) <sup>2)</sup> *	S METALOPORFIRINAS/TIOL	TIOL
/UPAA	著者抄録の更新日 <sup>1)</sup>	S MAR 2006/UPAA	UPAA
/UPAG	代理人の更新日 <sup>1)</sup>	S 20210101-20210601/UPAG	UPAG
/UPAT	著者標題の更新日 <sup>1)</sup>	S 21 APR 2006/UPAT	UPAT
/UPCL	クレームの更新日 <sup>1)</sup>	S 20060510/UPCL	UPCL

1) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

2) AND, IS, OF, THE, TO はこのフィールドでは索引されていません。これらの語を検索すると (1W) 演算子に置き換わります。

3) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには、引用符で囲んで検索します。

## 引用データの検索フィールド（引用特許）

中間一致および後方一致可能なフィールドはアスタリスク（\*）で示してあります。

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/AN.D (or OS.D)	引用レコード番号	S 2019-100035/AN.D	CDP
/CAT	カテゴリーコード	S BASF/PA.D(P)(X OR I)/CAT	CDP
/CAT.D	引用特許のカテゴリー	S BASF/PA.D(P)(X OR I)/CAT.D	CDP
/IN.D	引用特許の発明者	S BELLER M/IN.D	CDP
/ORC	引用者	S OPPOSITION/ORC	CDP
/PA.D	引用特許の特許出願人 <sup>1)</sup>	S HYUNDAI/PA.D	CDP
/PACO.D	引用特許の特許出願人コード <sup>2)</sup>	S HYMR/PACO.D	CDP
/PC.D(or RPC)	引用特許の特許発行国	S EP/PC.D	CDP
/PD.D(or RPD)	引用特許の特許発行日 <sup>3)</sup>	S 20200102/PD.D	CDP
/PK.D(or RPK)	引用特許の特許種別コード	S USA1/PK.D	CDP
/PN.D(or RPN)	引用特許の特許番号	S US20190062224/PN.D	CDP
/PY.D(or RPY)	引用特許の特許発行年 <sup>3)</sup>	S 2019/PY.D	CDP
/UPD	引用特許の更新日 <sup>3)</sup>	S 20211001/UPD	UPD

## 引用データの検索フィールド（引用文献）

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/CAT	カテゴリーコード	S BELLER/CDL(P)(X or I)/CAT	CDL
/CAT.D	引用文献のカテゴリー	S BELLER/CDL(P)(X or I)/CAT.D	CDL
/CDL(or /REN)	引用文献(引用特許を除く)*	S (TRANSDERMAL(2A)?PATCH?)/CDL	CDL
/DOI (or FTDOI)	デジタルオブジェクト識別子	S HTTPS://DOI.ORG/10.1109/SYSC SY.2015.7116836/DOI	DOI, CDL
/ORC(or /SRT)	引用者	S ?LIPASE?/CDL(P)E/ORC	CDL
/UPD	引用文献の更新日 <sup>3)</sup>	S 20211001/UPD	UPD
/XP (or /REXP)	XP 文献番号	S XP000000013/XP	XP, CDL

## 引用データの検索フィールド（被引用特許）

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/AN.G (or OS.G)	被引用特許のレコード番号	S 2019-000006/AN.G	CGP
/CAT	カテゴリーコード	S SIEMENS/PA.G(P)X/CAT	CGP
/CAT.G	被引用特許のカテゴリー	S SIEMENS/PA.G(P)X/CAT.G	CGP
/IN.G	被引用特許の発明者	S SMITH A/IN.G	CGP
/PA.G	被引用特許の特許出願人 <sup>1)</sup>	S ROHM HAAS/PA.G	CGP
/PACO.G	被引用特許の特許出願人コード <sup>2)</sup>	S MICT-C/PACO.G	CGP
/PC.G	被引用特許の特許発行国	S AU/PC.G	CGP
/PD.G	被引用特許の特許発行日 <sup>3)</sup>	S 20210105/PD.G	CGP
/PK.G	被引用特許の特許種別コード	S CNA/PK.G	CGP
/PN.G	被引用特許の特許番号	S JP06000043B/PN.G	CGP
/PY.G	被引用特許の特許発行年 <sup>3)</sup>	S 2017-2019/PY.G	CGP
/ORC (or /SRT)	引用者	S EP/PC.G(P)THIRDPARTY/ORC	CGP
/UPG	被引用特許の更新日 <sup>3)</sup>	S 20211001/UPG	UPG

1) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには、引用符で囲んで検索します。

2) このフィールドではシソーラスが利用できます。

3) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

## 引用数フィールド

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/ANC. D	引用DWPIレコード番号カウント <sup>3)</sup>	S ANC. D>20	CITC
/ANC. G	被引用DWPIレコード番号カウント <sup>3)</sup>	S 10-20/ANC. G	CITC
/CRC	引用文献カウント <sup>3)</sup>	S CRC<10	CITC
/PCC. D	引用特許発行国カウント <sup>3)</sup>	S 3-5/PCC. D	CITC
/PCC. G	被引用特許発行国カウント <sup>3)</sup>	S 10/PCC. G	CITC
/PNC. D	引用特許カウント <sup>3)</sup>	S PNC. D>30	CITC
/PNC. G	被引用特許カウント <sup>3)</sup>	S 30-30/PNC. G	CITC
/REC	引用総文献カウント <sup>3)</sup>	S REC>100	CITC

## 引用データの検索フィールド (ダウエントファミリーメンバー)

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/PC. F	ファミリーメンバーの特許発行国(引用, 被引用)	S CN/PC. F(P) JP/PC. D	CDP, CGP, CDL
/PK. F	ファミリーメンバーの特許種別コード(引用, 被引用)	S EPB#/PK. F(P) O/ORC	CDP, CGP, CDL
/PN. F	ファミリーメンバーの特許番号(引用, 被引用)	S EP1003890/PN. F	CDP, CGP, CDL

## 審査官調査フィールド

SEARCH コード	内 容	入 力 例	DISPLAY コード
/EXF. CPC	CPC の審査官調査フィールド	S A61K/EXF. CPC	EXF, EXFA
/EXF. IPC	IPC の審査官調査フィールド	S C12N0005/EXF. JPC	EXF, EXFA
/EXF. JPC	JPC の審査官調査フィールド	S C07D0239-00/EXF. JPC	EXF, EXFA
/EXF. USPC	USPC の審査官調査フィールド	S 101221000/EXF. USPC	EXF, EXFA

- 1) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときには、引用符で囲んで検索します。
- 2) このフィールドではシソーラスが利用できます。
- 3) 数値演算子または範囲指定検索が可能な数値検索フィールドです。

物性検索フィールド<sup>1)</sup>

タイトル、抄録、クレームの英語テキスト中に含まれる物性の数値を検索できます。物性値は専用の表示フィールドでは表示されませんが、フィールド (TI, AB, CLM) 中のヒットタームとしてハイライトされます。PHP フィールドを EXPAND すると検索可能な物性値がわかります。

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 <sup>5)</sup>
/AOS	物質量	S 10/AOS	mol
/BIR	ビットレート	S 100000-160000/BIR	bit/s
/BIT	保存情報	S BIT>3 MEGABIT (10A) STORAGE	bit
/CAP	静電容量	S 1-10 MF/CAP	F
/CATA	触媒活性	S 1-10/CATA	kat
/CDN	電流密度	S CDN>10 A/M**2	A/m <sup>2</sup>
/CMOL	モル濃度	S MOLYBD?/BI (S) 2/CMOL	mol/L
/CON	コンダクタンス	S 1E-2/CON	S (Siemens)
/DB	デシベル	S DB>50	dB
/DEG	角度	S (POLARI? (S) ANGLE)/BI (S) 45/DEG	° (degree)
/DEN または /C	密度, 質量濃度	S (CELL? (S) RECOMBIN?)/CLM (S) 5E-3-10E-3/DEN	kg/m <sup>3</sup>
/DEQ	線量当量	S DEQ>0.5 (S) RADIATION	Sv
/DOA	1日当たりの投与量	S 300/DOA	mg/kg/day
/DOS または /LD50	投与量	S DOS>0.8	mg/kg
/DV	動的粘度	S DV>5000	Pa s
/ECH または /CHA	電荷	S 10-15/ECH. EX (XA) CAPACITOR	C
/ECO または /ECND	電気伝導率	S ECO>1000 (XA) WIRE	S/m
/ELC または /ECC	電流	S 1-10/ELC	A
/ELF または /ECF	電場	S 1-5/ELF	V/m
/ENE	エネルギー	S L1 AND 10000/ENE	J
/ERE または /ERES	電気抵抗率	S ERE>10 (P) ISOLAT?	Ω m
/FOR	力	S 50 N/FOR	N
/FRE または /F	周波数	S ANALY?/CLM (10A) 0-3/FRE	Hz
/IU	国際単位	S IU>1000 (P) ANTIBIOTIC	IU
/KV	動粘性率	S LUBRICANT/BI (S) 10E-5/KV	m <sup>2</sup> /s
/LEN または /SIZ	長さ	S 1-4/LEN	m
/LUME	照度	S 10-50/LUME	lx
/LUMF	光束	S L74 (S) LUMF>70	lm
./LUMI	光度	S 5<LUMI<15	cd
/M	質量	S ALLOY/BI (30A) 1E-10-1E-5/M	kg
/MCH	質量電荷比	S MCH=3	m/z
/MFD または /MFS	磁束密度	S MFD. EX>0E-3 (S) MAGNETIC RESONANCE	T
/MFR または /MFL	質量流量	S MFR. EX<0E-3	kg/s
/MFST	磁界強度	S MFST/PHP	A/m
/MM または /MW, /MOM	モル質量, 分子量	S 2000-3000 G/MOL/MM	g/mol
/MOLS	質量モル濃度	S 0.1-10 mol/kg/MOLS	mol/kg
/MVR	メルトフローレート	S 5-10/MVR	g/10min
/PER	パーセント	S (TITAN? (3A) DIOXID?)/CLM (S) 5/PER	%

(続く)

物性検索フィールド<sup>1)</sup>(続き)

SEARCH コード	物性	SEARCH 例	デフォルト 単位 <sup>5)</sup>
/PHV または /PH	水素イオン指数	S 7.4-7.6/PHV	pH
/POW または /PW	電力	S (SOLAR? OR PHOTOVOLTAIC?)/BI (10A) 5-10/POW	W
/PPM /PRES または /P	ppm 圧力	S 100/PPM(10A)ADDITIVE/BI S (VACUUM (5A) DISTILL?)/BI (S) 1000-1100/PRES	ppm Pa
/RAD	放射能	S RADI?/BI (P) 10-100/RAD	Bq
/RES	電気抵抗	S CERAMIC/CLM (P) 1-8/RES	$\Omega$
/RI	屈折率	S 3-4/RI	なし
/RSP	回転速度	S 7000-8000/RSP AND ENGINE	rpm
/SAR	面積	S (COATING? OR FOIL?)/BI (S) 10-100/SAR	m <sup>2</sup>
/SOL または /SLB	溶解度	S SOL>20 (10W) WATER	g/100g
/SSAM	比表面積	S 9/SSAM	m <sup>2</sup> /kg
/STSC	表面張力, ばね定数	S 60 J/M**2/STSC	J/m <sup>2</sup>
/TCO	熱伝導率	S 30-40/TCO (S) THERMO?	W/m K
または /TCND			
/TEMP または /T	温度	S (REACTION? (25A) PHOSPHAT?) (S) 10/TEMP S 10/TEMP	K
/TEX	テックス	S 1-5/TEX	g/km
/TIM	時間	S ?INCUB?/CLM (10W) 10-50/TIM	s
/VEL または /V	速度	S PUMP?/BI (S) 1E-3-5E-3/VEL	m/s
/VELA	角速度	S ANG?/CLM (S) VELA>10	rad/s
/VLR	体積流量	S 2-5/VLR (XA) TUBE	m <sup>3</sup> /s
/VOL	体積	S ?FUSION?/BI (15A) 1E-8-2E- 8/VOL	m <sup>3</sup>
/VOLT	電圧	S CALIBRAT?/BI (10A) 5E- 3<VOLT<7E-3	V

1) 指数を用いて検索できます。例 : 18,000 は 1.8E+4 あるいは 1.8E4, 0.92 は 9.2E-1



### 国際特許分類（IPC）のシソーラス

国際特許分類第 8 版の分類を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。旧版（第 1 版～第 7 版）のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、/IPC に続けて各版の番号を入力します。（例； /IPC7）

関係コード	内 容	入 力 例
ADV	対応するアドバンスレベルの IPC コード	E A61K0006-02+ADV/IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00+ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E C01F0001-00+BT/IPC
CORE (COR)	対応するコアレベルの IPC コード	E C03B0001-02+COR/IPC
ED	入力した IPC の完全名と版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01B0001-00+HIE/IPC
INDEX	入力した IPC の完全名	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	入力語に関する IPC コード (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXTn	次の IPC コード (n は無しまたは数字)	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREVn	前の IPC コード (n は無しまたは数字)	E C01C0001-12+PREV3/IPC
RT (SIB)	関連語 (同じ階層の分類) (SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力した IPC と上位の完全名とコード (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

### 共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO) のシソーラス

共通特許分類 (/CPC), ヨーロッパ特許分類 (/EPC, /ICO) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語, 簡略表示 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E C12M0001-3446+ALL/CPC
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係語 (BT, SELF, CODE, DEF)	E G01J0003-443+AUTO/CPC
BT	上位語 (BT, SELF)	E G01J0003-443+BT/CPC
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E SCRAPER BIASING MEANS+CODE/CPC
DEF	定義 (SELF, DEF)	E B65G0045-16+DEF/CPC
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E A01B0001-00+HIE/CPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E LASER+KT/CPC
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, CODE, DEF, NT)	E G01J0003-447+MAX/CPC
NEXT	次の分類	E A01B0001-24+NEXT/CPC
NEXTn	次の n 個の分類	E A01B0001-24+NEXT3/CPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E G05B0001-04+NT/CPC
PREV	前の分類	E A61B0001-32+PREV/CPC
PREVn	前の n 個の分類	E G05B0019-418+PREV2/CPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E G05B0001-03+TI/CPC

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

## F ターム (/FTERM) のシソーラス

日本特許庁により付与される特許分類である F ターム (/FTERM) のシソーラスが利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT)	E 2B002/AA05+ALL/FTERM
BT	上位語 (SELF, BT)	E 2B002/AA05+BT/FTERM
CODE	シソーラステキスト語のコード	E PLYWOODS+CODE/FTERM
DEF	定義	E 2B002/BA13+DEF/FTERM
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語)	E 2B002/AA05+HIE/FTERM
KT	キーワードターム	E PLYWOODS+KT/FTERM
NT	下位語	E 2B002+NT/FTERM
RFI	関連 FI分類ターム	E 2B001+RFI/FTERM
TI	入力語および上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E 2B002/AA09+TI/FTERM

## FI (/FCL) のシソーラス

日本特許庁により付与される特許分類である FI (/FCL) のシソーラスが利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語	E A23B0004-00+ALL/FCL
MAX	すべての関連語 (BT, SELF, NT, RT, DEF)	E A23B0004-00+MAX/FCL
BT	上位語 (SELF, BT)	E A23B0004-00+BT/FCL
DEF	定義	E A23B0004-00+DEF/FCL
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語)	E A23B0004-00+HIE/FCL
INDX	インデックスノート	E C01F0001-00+INDX/FCL
NOTE	スコープノート	E F24F+NOTE/FCL
NT	下位語	E A23B0004-00+NT/FCL
RT	関連語	E F24F+RT/FCL
TI	入力語および上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E A23B0004-00+TI/FCL

## 米国特許分類 (/NCL) のシソーラス

米国特許分類 (/NCL) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 257E21685+ALL/NCL
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係コード (BT, SELF, DEF, NT)	E 02416300R+AUTO/NCL
BT	上位語 (BT, SELF)	E 02416300R+BT/NCL
CODE	分類コード (SELF, CODE)	E APPAREL+CODE/NCL
DEF	定義 (SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4)	E G9B031001+DEF/NCL
HIE	階層語 (BT, SELF, DEF, NT)	E 235487000+HIE/NCL
KT	キーワードターム (SELF, KT)	E APPAREL+KT/NCL
MAX	すべての関係語 (BT, SELF, DEF, DEF2, DEF3, DEF4, NT, KT)	E G9B031000+MAX/NCL
NEXT	次の分類	E G9B033035+NEXT/NCL
NEXTn	次の n 個の分類	E G9B033035+NEXT2/NCL
NT	下位語 (SELF, NT)	S 257E21685+NT/NCL
PREV	前の分類	E 235462260+PREV/NCL
PREVn	前の n 個の分類	E 235462260+PREV3/NCL
TI	入力した語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF, DEF)	E 052002110+TI/NCL

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードを付けずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。

### マニュアルコード (/MC) シソーラス

マニュアルコード (/MC) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, DEF, HNTE, SELF, NT)	E A03-A04A1+ALL/MC
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係語 (SELF, HNTE, DEF)	E S01-B05+AUTO/MC
BT	上位語 (BT, SELF)	E S06-B02A+BT/MC
NT	下位語 (NT, SELF)	E S06-B02+NT/MC

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTO とした結果と同じになります (デフォルトは SET REL OFF)。

### タイトルターム (/TT) シソーラス

タイトルターム (/TT) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E ABLATION+ALL/TT
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係語 (SELF, USE)	E FABRICATIONS+AUTO/TT
UF	非優先語 (SELF, UF)	E FABRICATE+UF/TT
USE	優先語 (SELF, USE)	E FABRICATED+USE/TT

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTO とした結果と同じになります (デフォルトは SET REL OFF)。

### 特許出願人コード (/PACO) シソーラス

特許出願人コードシソーラスは、頻出度の高い主な会社名を /PACO フィールドで確認できる機能です。特許出願人コードを EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL (CODE)	会社名に関連するすべての特許出願人コード	E BAYER+ALL/PACO
DEF	コードに対応するすべての会社名	E FARB-C+DEF/PACO

### ポリマー索引 (/PLE) シソーラス

新ポリマー索引 (/PLE) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NOTE, USE, SEE, UF, NT, RT)	E Q8457+ALL/PLE E CANS <APPLICATIONS> +ALL/PLE
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係語 (SELF, USE, UF)	E BACTERICIDE <ADDITIVES> +AUTO/PLE
BT	上位語 (BT, SELF)	E Q8457+BT/PLE
HIE	階層語 (BT, SELF, NT)	E Q8399+HIE/PLE
KT	キーワードターム (指定したキーワードを含むフレーズ) (SELF, KT)	E CANS+KT/PLE E POLYOL+KT/PLE
NT	下位語 (SELF, NT)	E Q8366+NT/PLE
RT	関連語 (SELF, RT)	E Q7034+RT/PLE
UF	非優先語 (SELF, UF)	E DIELECTRIC CONSTANT+UF/PLE
USE	優先語 (SELF, USE)	E BIOCIDES <ADDITIVES> +USE/PLE

1) SET REL ON の状態で関係コードを付けずに EXPAND または SEARCH した場合は、関係コードを AUTO とした結果と同じになります (デフォルトは SET REL OFF)。

**プラスドックキーシリアル (/KS) シソーラス**

プラスドックキーシリアル (/KS) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (CODE, DEF)	E GASEOUS+ALL/KS

**ダウエント化合物番号 (/DCN) シソーラスの関係コード**

ダウエント化合物番号 (/DCN) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E R09609+ALL/DCN
UF	非優先語 (SELF, UF)	E R22401+UF/DCN
USE	優先語 (SELF, USE)	E ACETIC ACID+USE/DCN

**ダウエント登録番号 (/DRN) シソーラス**

ダウエント登録番号 (/DRN) を EXPAND/SEARCH する際、下記の関係コードを利用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, USE, UF)	E 0495+ALL/DRN
UF	非優先語 (SELF, UF)	E 1314+UF/DRN
USE	優先語 (SELF, USE)	E ACETIC ACID+USE/DRN

## 表示形式

回答の表示をする際は、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。

複数のコードはスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

入力例 ; => D L1 1-5 BIB ABS

=> D L1 TI, AU, SO, CS, AB

## カスタム表示形式

表示形式	英語名	内 容	入 力 例
AB	Abstract (Basic)	抄録 (Basic 特許, UPAB を含む)	D TI PA AB
ABDT <sup>1)</sup>	Abstract, Documentation Type	ドキュメンテーション抄録	D ABDT
ABEQ	Abstract, Equivalent	対応特許抄録	D ABEQ
ABEX <sup>1)</sup>	Abstract, Extended	拡張抄録 (UPTX を含む)	D ABEX
ACTN	Mechanism of Action	Mechanism of Action	D ACTN
ACTV	Activity	Activity	D ACTV
ADT <sup>2)</sup>	Application Details	出願情報の詳細	D ADT
ADT.B <sup>2)</sup>	Application Details, Basic	出願情報の詳細, Basic 特許	D 1-5 ADT. B
ADV	Advantage	Advantage	D ADV
AI (AP) <sup>2)</sup>	Application Information	出願情報	D AI PI
AI.B	Application Information, Basic	出願情報, Basic 特許	D AI. B
ALE	Alerting Abstract, First Section	抄録の第一セクション	D ALE
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
ANX	Crossover Accession Number	クロスオーバーレコード番号	D ANX
AW	Additional Words	追加語	D AW
CMC	Chemical Code	ケミカルコード	D CMC
CPC	Cooperative Patent Classification	共通特許分類	D CPC
CPC. TAB	CPC, Tabular Display of CPC, CPC.KW, CPC.ACD, CPC.VER	共通特許分類, 表形式 (キーワード, 発行日, 版)	D CPC. TAB
CR (XR)	Cross Reference	クロスリファレンス	D AN CR
CYC	Country Count	特許発行国数	D CYC
DC	DWPI Class	ダウメントクラス	D DC
DCN	DWPI Compound Number	ダウメント化合物番号	D DCN
DCR	Chemical Resource Number	DCR 番号	D DCR
DCRU	Chemical Resource Number, Unlinked	DCR 番号, 未リンク	D DCRU
DETD	Detailed Description	詳細な説明	D DETD
DN	Document Number (DNC and DNN)	第二次アクセッション番号	D DN
DNC	Document Number CPI	第二次アクセッション番号 CPI	D DNC
DNN	Document Number Non CPI	第二次アクセッション番号 CPI 以外	D DNN
DRN	DWPI Registry Number	ダウメント登録番号	D DRN
DRWD	Description of Drawings	図面の説明	D DRWD
DRWN	Number of Drawings	図面の数	D DRWN
DS	Designated State	指定国	D DS
DUPD	DWPI Update	Clarivate Analytics アップデート	D DUPD
ED	Entry Date	入力日	D ED
EPC (ECLA, EPCLA)	European Patent Classification	ヨーロッパ特許分類	D EPC
FA	Field Availability	フィールドの存在	D FA
FCL (JPC)	Japanese Patent Classification (FI or File Index)	FI	D FCL
FDT	Filing Details	出願経過の詳細	D FDT
FG (AM)	Fragment Code	フラグメンテーションコード	D FG
FS	File Segment	ファイルセグメント	D FS
FTRM (FTERM, FTCLA, JPCLA)	Japanese Patent Classification (FTERM or File Forming Term)	F ターム	D FTRM

## カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
GI (GI. H)	Graphic Information	図面情報	D GI
GINF (GIS)	Graphic Image(s) Information	図面関連情報	D GINF
IC	International Patent Classification (includes ICM and ICS)	国際特許分類 (主分類・副分類を含む)	D TI PA IC
ICA	IPC, Additional (Supplementary)	国際特許分類, 追加分類 (参考情報)	DISPLAY ICA
ICI	IPC, Index (Complementary)	国際特許分類, インデキシング コード (相補情報)	D ICI
ICM	IPC, Main	国際特許分類, 主分類	D ICM
ICO	Index Codes (EPO)	コンピュータ分類 (EPO)	D ICO
ICS	IPC, Secondary	国際特許分類, 副分類	D ICS
IN (AU)	Inventor	発明者名	D IN
IPC	International Patent Classification (ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR)	国際特許分類	D IPC
IPC. TAB	IPC, Tabular Display of IPC, IPC. KW, IPC. ACD, IPC. VER	国際特許分類, 表形式	D IPC. TAB
IPCI	IPC, Initial	国際特許分類, 発行時	D IPCI
IPCR	IPC, Reclassified	国際特許分類, 再分類	D IPCR
IT (KW)	Index Term	索引	D IT
KS	Plasdoc Key Serials	プラスドックキーシリアル番号	D KS
MO-M6	Chemical Codes	ケミカルコード	
MC	Manual Code	マニュアルコード	D M1
NCL	US National Patent Classification, Current	米国特許分類 (現行)	D MC D NCL
NOV	Novelty	Novelty	D NOV
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人 (コードを含む)	D IN PA PI
PATS	Patent Number Group	特許番号グループ	D PATS
PI <sup>2), 3)</sup>	Patent Information	特許情報	D PI
PI. B <sup>2), 3)</sup>	Patent Information Basic	特許情報, Basic 特許	D PI. B
PN <sup>2), 3)</sup>	Patent Number	特許番号 (指定国情報を除く)	D PN
PN. B	Patent Number, Basic	特許番号, Basic 特許 (指定国 情報を除く)	D PN. B
PNC	Patent Number Count	特許番号数	D PNC
PNK	Patent Number/Kind code	種別付き特許番号	D PNK
PNK. B	Patent Number/Kind code, Basic	種別付き特許番号, Basic 特許	D PNK. B
PLC	Polymer Coding Plasdoc	プラスドックポリマー索引	D PLC
PLE	Polymer Indexing Enhanced	新ポリマー索引 (UPA を含む)	D PLE
PRAI (PRN) <sup>2)</sup>	Priority Information	優先権情報	D PI PRAI
RIN	Ring Index Number	リングインデックス番号	D RIN
RINU	Ring Index Number, Unlinked	リングインデックス番号, 未リンク	D RINU
TECH	Technology Focus	Technology Focus (UPTX を含む)	D TECH
TI	Title	標題	D TI
TT	Title Terms	タイトルターム	D TT
UADV	Use/Advantage Section	Use/Advantage	D UADV
UP	Update Date	更新日	D UP AN
UPA	Update Date Polymer Indexing	ポリマー索引の更新日	D UPA
UPAB	Update Date Abstract	抄録の更新日	D UPAB
UPB	Update Date Chemical Code	ケミカルコードの更新日	D UPB
UPCP	Update Date Cooperative Patent Classification	CPC の更新日	D UPCP
UPFT	Update Date Japanese Patent Classification	FI, Fタームの更新日	D UPFT
UPIC	Update International Patent Classification code	国際特許分類の更新日	D UPIC
UPIN	Update Inventor	発明者の更新日	D UPIN
UPIT (UPKW)	Update Date Index Terms	索引の更新日	D UPIT

## カスタム表示形式 (続き)

表示形式	英語名	内容	入力例
UPP	Update Date Patent Family	特許ファミリーの更新日	D UPP
UPPA	Update Date Patent Assignee	特許出願人の更新日	D UPPA
UPMC	Update Date Manual Code	マニュアルコードの更新日	D UPMC
UPP	Update Date Patent Family	特許ファミリーの更新日	D UPP
UPTI	Update Date Enhanced Title	標題の更新日	D UPTI
USE	Use Section	Use	D USE

- 1) WPIX ファイルでのみ利用可能です。
- 2) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます. DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変更可能で, STN 形式がデフォルトです. ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, => SET PAT DERWENT (PERM) と入力します. STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します.
- 3) パテントファミリー表示中では, ベーシック特許は “\*” で, ベーシックとして扱われる対応特許は “B” で, パリ条約に基づいていない対応特許を “#” で識別します.

## 定型表示形式

表示形式	内容	入力例
ABS	抄録	D TI PA ABS
ALL <sup>1)</sup>	AN, CR, AB, UPAB, ABEQ 発明レベルのすべてのデータ (対応特許抄録, Technology Focus, ケミカルコード, ポリマー索引, ドキュメンテーション抄録*, 拡張抄録*を除く)	D ALL
DALL <sup>1)</sup>	AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, MC	D DALL
IALL <sup>1)</sup>	デリミタ型 ALL 形式	D IALL
ALLG <sup>1)</sup>	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D ALLG
IALLG <sup>1)</sup>	イメージ情報付き ALL	D IALLG
ANL	フィールド名付きインデント型 ALLG 形式	D ANL
APPS <sup>1)</sup>	レコード番号リスト (回答番号なし)	D APPS
BASIC <sup>1)</sup>	ADT, PRAI	D BASIC
BIB <sup>1)</sup>	AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, PNC, CYC, PN. B, ADT. B, PRAI, AB, UPAB, FS	D BIB
IBIB <sup>1)</sup>	書誌情報	D IBIB
BRIEF	AN, CR, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PIA, ADT, FDT, PRAI	D BRIEF
IBRIEF	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBRIEF
BRIEFG	書誌情報 (特許情報なし)	D BRIEFG
IBRIEFG	AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, PA, AB, UPAB	D IBRIEFG
CODE (IND)	フィールド名付きインデント型 BRIEFG 形式	D CODE
CPC. TAB	AN, DC, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, MC, IT, DRN, PLC, PLE, CMC	D CPC. TAB
FAM <sup>1)</sup>	CPC, 表形式	D FAM
FULL <sup>1)2)</sup>	PI, ADT, FDT, PRAI	D FULL
IFULL <sup>1)2)</sup>	発明レベルのすべてのデータ (対応特許抄録, ケミカルコード, ポリマー索引を除く. ただし Technology Focus, ドキュメンテーション抄録, 拡張抄録は含む)	D IFULL
FULLG <sup>1)2)</sup>	AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PN, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, TECH, ABEX, FS, MC, ABDT	D FULLG
IFULLG <sup>1)2)</sup>	フィールド名付きインデント型 FULL 形式	D IFULLG
IPC	イメージ情報付き FULL	D IPC
IPC. TAB	フィールド名付きインデント型 FULLG 形式	D IPC. TAB
	IC (ICM, ICS), ICA, ICI, IPCI, IPCR	
	詳細な IPC 情報 (表形式)	

## 定型表示形式 (続き)

表示形式	内 容	入 力 例
MAX <sup>1)2)</sup>	発明レベルのすべてのデータ (ケミカルコード, ポリマー索引, Technology Focus, ドキュメンテーション抄録, 拡張抄録を含む) AN, ED, CR, ANX, DNC, DNN, TI, AW, DC, IN, PA, CYC, PN, ADT, FDT, PRAI, IPC, CPC, EPC, ICO, NCL, FCL, FTRM, AB, UPAB, SL, ABEQ, TECH, ABEX, ABDT, IT, FS, MC, PLC, PLE, CMC	D MAX
IMAX <sup>1)2)</sup>	フィールド名付きインデント型 MAX 形式	D IMAX
MAXG <sup>1)2)</sup>	イメージ情報付き MAX	D MAXG
IMAXG <sup>1)2)</sup>	フィールド名付きインデント型 MAXG 形式	D IMAXG
PATS <sup>1)</sup>	PI, FDT	D PATS
SCAN <sup>3)</sup>	回答チェック用の表示形式 (回答番号なしのランダム表示) AN (WPIDS/WPIX ファイルのみ), TI	D SCAN
STD <sup>1)</sup> (デフォルト)	書誌情報, 特許分類 AN, CR, DNN, DNC, TI, DC, IN, PA, CYC, PN, ADT, FDT, PRAI, IPC	D STD CMC
ISTD <sup>1)</sup>	フィールド名付きインデント型 STD 形式	D ISTD
SUM	AN, TI, NOV	D SUM
TRIAL (TRI, SAMPLE)	回答チェック用の表示形式 AN, CR, ANX, DNN, DNC, TI (WPIDS/WPIXファイルのみ), TT (WPINDEX ファイルのみ), DC, IPC, CPC, EPC, ICO, MC	D TRI
UPP	特許ファミリーの更新日	D UPP

- 1) 出願番号、優先権出願番号、特許番号、国際特許分類は、ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は、SET PATENT コマンドで変更可能で、STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには、=> SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は => SET PAT STN と入力します。
- 2) ABDT と ABEX は WPIX ファイルでのみ利用できます。
- 3) SCAN はコマンドに続けて入力します。例:D SCAN または DISPLAY SCAN



## カスタム表示形式 (公報レベル)

表示形式	英語名	内容	入力例
ABDE	Abstract, Original, in German	抄録, オリジナル (ドイツ語)	D ABDE
ABEN	Abstract, Original, in English	抄録, オリジナル (英語)	D ABEN
ABES	Abstract, Original, in Spanish	抄録, オリジナル (スペイン語)	D ABES
ABFR	Abstract, Original, in French	抄録, オリジナル (フランス語)	D ABFR
ABOL	Abstract, Original, other languages	抄録, オリジナル (その他の言語)	D ABOL
AG	Agent	代理人	D AG
AG.T	Agent, Total	代理人 (全フィールド)	D AG.T
AGA	Agent Address	代理人住所	D AGA
APTS	Application Information, Clarivate Analytics	出願情報 (Clarivate Analytics)	D APTS
CLM	Claims (すべての言語)	クレーム	D CLM
CLMDE <sup>1)</sup>	Claims in German	クレーム (ドイツ語)	D CLMDE
CLMEN <sup>1)</sup>	Claims in English	クレーム (英語)	D CLMEN
CLMES <sup>1)</sup>	Claims in Spanish	クレーム (スペイン語)	D CLMES
CLMFR <sup>1)</sup>	Claims in French	クレーム (フランス語)	D CLMFR
CLMOL <sup>1)</sup>	Claims in other languages	クレーム (その他の言語)	D CLMOL
GI.M	Graphic Information, Member Patent	図面イメージ, 公報レベル	D GI.M
IIC	Initial International Patent Classification (ICM, ICS)	国際特許分類, 発行時 (主分類, 副分類)	D IIC
IICA	Initial IPC, Additional (supplementary)	国際特許分類, 発行時 追加分類 (参考情報)	D IICA
IICI	Initial IPC, Index (complementary)	国際特許分類, 発行時 インデキシングコード (相補情報記号)	D IICI
IICM	Initial IPC, Main	国際特許分類, 発行時 主分類	D IICM
IICS	Initial IPC, Secondary	国際特許分類, 発行時 副分類	D IICS
IN.T	Inventor, Total	発明者 (全フィールド)	D IN.T
INA	Inventor Address	発明者のアドレス	D INA
INCL	National Classification, Issued	米国特許分類, 発行時	D INCL
INO	Inventor, Original	発明者, オリジナル	D INO
CPC.TAB.M	CPC, Tabular Display, Member	共通特許分類, 表形式 (公報レベル)	D CPC.TAB.M
IPC.TAB.M	IPC, Tabular Display, Member	国際特許分類, 表形式 (公報レベル)	D IPC.TAB.M
PA.T	Patent Assignee, Total	特許出願人 (全フィールド)	D PA.T
PAA	Patent Assignee Address	特許出願人住所	D PAA
PAO	Patent Assignee, Original	特許出願人, オリジナル	D PAO
PRTS	Priority Application Information, Clarivate	優先権出願情報 (Clarivate)	D PRTS
TIDE	Title, Original, in German	原標題 (ドイツ語)	D TIDE
TIEN	Title, Original, in English	原標題 (英語)	D TIEN
TIES	Title, Original, in Spanish	原標題 (スペイン語)	D TIES
TIFR	Title, Original, in French	原標題 (フランス語)	D TIFR
TIOL	Title, Original, in other languages	原標題 (その他の言語)	D TIOL
UPAA <sup>1)</sup>	Update date Author Abstract	著者抄録の更新日	D UPAA
UPAG <sup>1)</sup>	Update date Agent	代理人の更新日	D UPAG
UPAT <sup>1)</sup>	Update date Author Title	著者標題の更新日	D UPAT
UPCL	Update date Claim	クレームの更新日	D UPCL

1) カスタム形式のみの表示です。

定型表示形式 (公報レベル)

表示形式	内 容	入 力 例
MEMB <sup>1)</sup>	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 (著者抄録, クレームを含む以下のフィールド) PN TIEN, TIDE, TIFR, TIES, TIOL, AG, IN, INO, INA, PA, PAO, PAA, ADT, APTS, FDT, PRAI, PRTS, IPC, IIC, IICI, IICA, CPC, EPC, ICO, NCL, INCL, FCL, FTRM, ABEQ, ABEN, ABDE, ABFR, ABES, ABOL, CLM, UPCL	D ALL MEMB
MEMBG <sup>1)</sup>	イメージ情報付き MEMB	D MEMBG
MEMBB <sup>1)</sup>	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 (著者抄 録, クレームを含む以下のフィールド) PN, TI, TIEN, TIDE, TIFR, TIES, AG.T, IN.T, PA.T, ABEN, ABDE, ABFR, ABES, ABOL, CLM	D MEMBB
MEMBF <sup>1)2)</sup>	レコードに含まれるすべての公報レベルの以下の情報 AN, ED, CR, ANX, DNC, DNN, TI, TIEN, TIDE, TIFR, TIES, TIOL, AW, DC, AG, IN, INO, INA, PA, PAO, PAA, CYC, PN, ADT, APTS, FDT, PRAI, PRTS, IPC, IIC, IICA, CPC, EPC, ICO, NCL, INCL, FCL, FTRM, AB, ABEQ, TECH, ABEX, ABDT, ABDE, ABEN, ABFR, ABES, ABOL, CLM, UPCL, IT, FS, MC, FA	D MEMBF
MEMBFG <sup>1),2)</sup>	イメージ情報付き MEMBF	D MEMBFG

1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, 国際特許分類は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示  
できます. DISPLAY, PRINT, SELECT, ANALYZE および SORT のための形式は, SET PATENT コマンドで変  
更可能で, STN 形式がデフォルトです. ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, SET PAT  
DERWENT (PERM) と入力します. STN 形式に戻す場合は SET PAT STN と入力します.

2) ABDT と ABEX は WPIX ファイルでのみ利用可能です.

引用データ関連の表示形式

表示形式	内 容	入 力 例
CITD (RE)	引用特許情報 (EXF, CDP, CDL)	D CITD
CITDA	引用特許情報(省略形式) (EXFA, CDPA, CDLA)	D CITDA
CITN	引用, 被引用特許カウント (CITC, EXF, CDP, CDL, CGP)	D CITN
CITNA	引用, 被引用特許カウント(省略形式) (CITC, EXFA, CDPA, CDLA, CGPA)	D CITNA

ヒットタームに関する表示形式

表示形式	内 容	入 力 例
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
HITCMC	ヒットしたケミカルコード	D HITCMC
HITCODE	ヒットタームを含む DC, IPC, CPC, EPC, NCL, FC, FTERM, IT, DR N, MC, PLC, PLE, CMC	D HITCODE
HITMEMB	ヒットタームを含む公報レベルのフィールド	D HITMEMB
HITPLC	ヒットしたプラスドックポリマー索引	D HITPLC
HITPLE	ヒットした新ポリマー索引	D HITPLE
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC
ALLSTR	レコード中の索引されている全物質	D ALLSTR
HITSTR	ヒットした物質	D HITSTR
AHITSTR	ヒットした部分を組み立てた形式の構造	D AHITSTR
BHITSTR	基本骨格とヒットに関与する G グループの定義	D BHITSTR
FHITSTR	基本骨格とすべての G グループの定義	D FHITSTR
FRAGHITSTR	ヒットしたフラグメンテーションコードに対応する物質	D FRAGHITSTR

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT/ANALYZE コマンドは抽出・解析用のコマンドです。

SORT コマンドは指定したフィールドのアルファベット順または数値順に検索結果を並び替えるコマンドです。

○は SELECT/ANALYZE/SORT 可能なコード、× は不可能なコードです。

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
AC	出願国	○	×
AC. B	出願国, ベーシック特許	○	×
ACTV	Activity	○	×
AD	出願日	○	×
AD. B	出願日, ベーシック特許	○	×
AN	レコード番号	○	○
ANX	クロスオーバーレコード番号	○	×
AP (AI, ADT)	出願番号	○ <sup>2)</sup>	○
AP. B (AI. B)	出願番号, ベーシック特許	○ <sup>2)</sup>	×
AP. YR	出願番号, 年	○	×
APPS	出願番号グループ	○ <sup>2)3)</sup>	×
AY	出願年	○	×
AY. B	出願年, ベーシック特許	○	×
CR (XR)	クロスリファレンス	○	×
CPC	共通特許分類	○	×
CYC	特許発行国数	○	○
DC	ダウエントクラス	○	○
DCN	ダウエント化合物番号	○	×
DCR	DCR レコード番号	○	×
DCR. WR	ロール付き DCR レコード番号	○	×
DN	第二次アクセス番号	○ <sup>4)</sup>	×
DNC	第二次アクセス番号 CPI	○	○
DNN	第二次アクセス番号 CPI 以外	○	○
DRN	ダウエント登録番号	○	×
DRWN	図面の数	○	○
DS	指定国	○	×
DUPD	ダウエントウィーク, first and latest	○	○
DW	ダウエントウィーク	○ <sup>5)</sup>	○
DW. B	ダウエントウィーク, Basic 特許	○ <sup>5)</sup>	×
ED	入力日	○	○
EPC (ECLA, EPCLA)	ヨーロッパ特許分類	○	×
FACL	FI (追加分類)	○	×
FCL (JPC)	FI	○	×
FDT	出願経過の詳細	○	×
FDT. PC (RLPC)	出願経過の詳細, 特許発行国	○	×
FDT. PK (RLPK)	出願経過の詳細, 特許種別コード	○	×
FDT. PN (RLPN)	出願経過の詳細, 特許番号	○	×
FDT. TP	出願経過の詳細, 出願タイプ	○	×
FICL	FI (インデキシング)	○	×
FS	ファイルセグメント	○	○
FMCL	FI (主分類)	○	○
FSCL	FI (副分類)	○	×
FTRM (FTERM, FTCLA, JPCLA)	F ターム	○	×

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
IC	国際特許分類, 主分類, 副分類 (IPC1-7)	○	×
ICA	国際特許分類, 追加分類 (IPC1-7)	○	×
ICI	国際特許分類, インデキシングコード, (IPC1-7)	○	×
ICM	国際特許分類, 主分類 (IPC1-7)	○	○
ICO	コンピュータ分類 (EPO)	○	×
ICS	国際特許分類, 副分類 (IPC1-7)	○	×
IN (AU)	発明者	○	○
IPC	国際特許分類 (ICM, ICS, ICA, ICI, IPCI, IPCR)	○	×
IPC.F	国際特許分類, Main or First	○	○
IT (KW)	索引	○	×
LA	出願言語	○ <sup>5)</sup>	×
MC	マニュアルコード	○	×
MCN	マルクレーシュ構造番号	○	×
MCN.WR	マルクレーシュ構造番号、ロール付き	○	×
NCL	米国特許分類	○	○
NCLM	米国特許分類, 主分類	○ <sup>12)</sup>	○
NCLS	米国特許分類, 副分類	○ <sup>12)</sup>	×
PA (CS)	特許出願人名	○	○
PACO	特許出願人コード	○	○
PATS	特許番号グループ	○ <sup>10)</sup>	×
PAX	特許出願人名および特許出願人コード	○	×
PC	特許発行国	○	○
PC.B	特許発行国, Basic 特許	○	○
PCS	特許発行国グループ	○ <sup>7)</sup>	×
PD	特許発行日	○	○
PD.B	特許発行日, Basic 特許	○	○
PK	特許種別コード	○	○
PK.B	特許種別コード, Basic 特許	○	○
PLE	新ポリマー索引	○	×
PN (PI)	特許番号	○ <sup>8)</sup>	○
PN.B (PI.B)	特許番号, Basic 特許	○ <sup>9)</sup>	○
PNC	特許番号数	○	○
PNK	種別付き特許番号	○	×
PNK.B	種別付き特許番号, Basic 特許	○	×
PRN (PRAI)	優先権出願番号	○ <sup>11)</sup>	○
PRNF	最先の優先権出願番号	○	×
PRN.B	優先権出願番号, Basic 特許	○	×
PRN.YR	優先権出願番号, 年	○	×
PRC	優先権主張国	○	×
PRC.B	優先権主張国, Basic 特許	○	×
PRCF	最先の優先権主張国	○	×
PRD	優先権主張日	○	○
PRD.B	優先権主張日, Basic 特許	○	×
PRDF	最先の優先権主張日	○	○
PRY	優先権主張年	○	○
PRYF	最先の優先権主張年	○	○
PY	特許発行年	○	○
PY.B	特許発行年, Basic 特許	○	○
RIN	リングインデックス番号	○	×
RINU	リングインデックス番号, 未リンク	○	×

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (続き)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
UP	更新日	○	○
UPA	ポリマーコードの更新日	×	○
UPFT	F-term, FIの更新日	×	○
UPMC	マニュアルコードの更新日	×	○
UPIN	発明者の更新日	○	○
UPIT (UPKW)	索引の更新日	○	○
UPP	特許ファミリーの更新日	○	○
UPPA	特許出願人の更新日	×	○
UPTI	標題の更新日	×	○

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います (例 : => SEL HIT TI)
- 2) 出願番号、優先権番号、および特許番号は SET PATENT コマンドで設定されている形式 (ダウエント形式または STN 形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます。
- 3) 出願番号、優先権番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /APPS が付与されます。
- 4) 抽出された DNC, DNN のタームに /DN が付与されます。
- 5) このフィールドでは SEL HIT や ANALYZE HIT は利用できません。
- 6) SELECT で抽出されたタームに /IPC が付与されます。
- 7) 特許発行国と指定国が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PCS が付与されます。
- 8) 特許番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PN が付与されます。
- 9) Basic 特許の特許番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PN.B が付与されます。
- 10) 特許番号、出願番号の詳細における特許番号 (FDT.PN) が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PATS が付与されます。
- 11) 優先権出願番号が抽出され、SELECT で抽出されたタームに /PRN が付与されます。
- 12) SELECT で抽出されたタームに /NCL が付与されます。

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (公報レベルのみ)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
AG	代理人	○	○
AG. T	代理人 (全フィールド)	○	×
AGA	代理人住所	○	○
AGA. CNY	代理人住所, 国	○	○
AGA. CTY	代理人住所, 市	○	○
AG. ZIP	代理人住所、郵便番号	○	○
AG. ST	代理人住所、州	○	○
AN. PUB	レコード番号, 公報レベル	○	×
APTS	出願情報 (Clarivate)	○	×
IIC	国際特許分類, 発行時	○	×
IICA	国際特許分類, 追加分類,	○	×
IICI	国際特許分類, インデキシングコード	○	×
IICM	国際特許分類, 発行時, 主分類	○	○
IICS	国際特許分類, 発行時, 副分類	○	×
IN. NAT	発明者, 国籍	○	○
IN. T	発明者 (全フィールド)	○	×
INA	発明者住所	○	×
INA. CNY	発明者住所, 国	○	○
INA. CTY	発明者住所, 市	○	○
INCL	米国特許分類, 発行時	○	○
INCLM	米国特許分類, 発行時, 主分類	○	×
INCLS	米国特許分類, 発行時, 副分類	○	×
INO	発明者, オリジナル	○	○
IN. ZIP	発明者、郵便番号	○	○
IN. RES	発明者、所在地	○	○
IN. ST	発明者、州	○	○
PA. NAT	特許出願人, 国籍	○	○
PA. LIM	特許出願人, 国	○	○
PA. RES	特許出願人, 所在地	○	○
PA. T	特許出願人 (全フィールド)	○	○
PAA	特許出願人住所	○	×
PAA. CNY	特許出願人住所, 国	○	○
PAA. CTY	特許出願人住所, 市	○	○
PAO	特許出願人住所, オリジナル	○	○
PRTS	優先権情報 (Clarivate Analytics)	○	×
UPAG	代理人の更新日	×	○
UPAA	著者抄録の更新日	×	○
UPAT	著者標題の更新日	×	○
UPCL	クレームの更新日	×	○

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには, HIT を使います (例 : => SEL HIT TI).

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (引用情報)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
CAT	カテゴリコード	○	×
CAT. D	引用文献のカテゴリ	○	×
CAT. G	被引用特許のカテゴリ	○	×
AN. D	引用レコード番号	○	×
IN. D	引用特許の発明者	○	×
PA. D	引用特許の特許出願人	○ <sup>2)</sup>	×
PACO. D	引用特許の特許出願人コード	○ <sup>2)</sup>	×
PAX. D	引用特許の特許出願人コードと特許出願人名	○	×
PC. D	引用特許の特許発行国	○ <sup>2)</sup>	×
PD. D	引用特許の特許発行日	○ <sup>2)</sup>	×
PK. D	引用特許の特許種別コード	○ <sup>2)</sup>	×
PN. D	引用特許の特許番号	○ <sup>2)</sup>	×
PY. D	引用特許の特許発行年	○ <sup>2)</sup>	×
AN. G	被引用特許のレコード	○	×
IN. G	番号被引用特許の発明者	○	×
PA. G	被引用特許の特許出願人	○ <sup>2)</sup>	×
PACO. G	被引用特許の特許出願人コード	○ <sup>2)</sup>	×
PAX. G	被引用特許の特許出願人コードと特許出願人名	○	×
PC. G	被引用特許の特許発行国	○ <sup>2)</sup>	×
PD. G	被引用特許の特許発行日	○ <sup>2)</sup>	×
PK. G	被引用特許の特許種別コード	○ <sup>2)</sup>	×
PN. G	被引用特許の特許番号	○ <sup>2)</sup>	×
PY. G	被引用特許の特許発行年	○ <sup>2)</sup>	×
DOI	デジタルオブジェクト識別子	○ <sup>2)</sup>	×
ORC	引用者	○	×
UPD	引用文献の更新日	×	○
UPG	被引用特許の更新日	×	○
XP	XP 文献番号	○	×

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには、HIT を使います (例 : => SEL HIT PA. D)

2) このフィールドでは SEL HIT や ANALYZE HIT は利用できません。

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド (引用情報のカウント)

SELECT/ANALYZE/ SORT コード	内 容	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
ANC. D	引用DWPIレコード番号カウント	○	○
CRC	引用文献カウント	○	○
PNC. D	引用特許カウント	○	○
PCC. D	引用特許発行国カウント	○	○
REC	引用総文献カウント	○	○
ANC. G	被引用DWPIレコード番号カウント	○	○
PNC. G	被引用特許カウント	○	○
PCC. G	被引用特許発行国カウント	○	○

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには、HIT を使います (例 : => SEL HIT PNC. G)

サンプルレコード

IFULLG 形式での表示

L1 ANSWER 1 OF 1 WPIX COPYRIGHT 2023 CLARIVATE on STN  
 レコード番号 ACCESSION NUMBER: [2018-08951P](#) [201812] WPIX [Full-text](#)  
 CROSS REFERENCE: 2018-08951J; 2018-08951L; 2018-08951M; 2018-08951N;  
 2018-08951Q; 2018-08991C; 2018-65567S; 2019-71222S;  
 2019-71222T; 2021-08476T; 2022-153370; 2023-315094  
 標題 TITLE: Transdermal delivery system for administering donepezil  
 base used for treating Alzheimer's disease, comprises  
 skin contact adhesive layer, and drug reservoir  
 comprising acrylate copolymer, glycerin and donepezil  
 base  
 ダウエントクラス DERWENT CLASS: A96; B03; B05; B07  
 発明者名 INVENTOR: JAIN A K; LEE E S; SAGI A; SINGH P  
 特許出願人 PATENT ASSIGNEE: (RIUM-C) CORIUM INC; (RIUM-C) CORIUM INT INC; (RIUM-C)  
 CORIUM LLC; (CORI-N) CORIUM INT INC  
 特許発行国数 COUNTRY COUNT: 135  
 特許情報 PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG
US 20180028462	A1	20180201	(201812)	* EN	24[5]
WO 2018022815	A3	20180308	(201818)	EN	
AU 2017302306	A1	20190214	(201913)	EN	
CA 3031945	A1	20180201	(201913)	EN	
KR 2019034601	A	20190402	(201927)	KO	
US 10300025	B2	20190528	(201940)	EN	
CN 109789105	A	20190521	(201941)	ZH	
EP 3490541	A2	20190605	(201942)	EN	
JP 2019523268	T	20190822	(201964)	JA	34

出願情報の詳細 APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
US 20180028462	A1	US 2017-15660939	20170726
US 20180028462	A1 Provisional	US 2017-504408P	20170510
US 20180028462	A1 Provisional	US 2017-504391P	20170510
AU 2017302306	A1	AU 2017-302306	20170726
CA 3031945	A1	CA 2017-3031945	20170726
CN 109789105	A	CN 2017-80059417	20170726
CN 109789105	B	CN 2017-80059417	20170726
EP 3490541	A2	EP 2017-749568	20170726
US 10300025	B2	US 2017-15660939	20170726

出願経過の詳細 FILING DETAILS:

PATENT NO	KIND	PATENT NO
CN 109789105	B	Previous Publ CN 109789105 A
JP 7153010	B2	Previous Publ JP 2019523268 T
JP 7251033	B2	Previous Publ JP 2019523270 T
US 10300025	B2	Previous Publ US 2018028462 A
CA 3031945	A1	Based on WO 2018022815 A
AU 2017302306	A1	Based on WO 2018022815 A
KR 2019034601	A	Based on WO 2018022815 A
CN 109789105	A	Based on WO 2018022815 A
EP 3490541	A2	Based on WO 2018022815 A



優先権出願情報 PRIORITY APPLN. INFO: US 2017-15660939 20170726  
 US 2017-504391P 20170510  
 US 2017-504408P 20170510  
 US 2017-457794P 20170210  
 US 2017-444745P 20170110  
 US 2017-444763P 20170110  
 US 2016-423133P 20161116  
 US 2016-367502P 20160727  
 US 2016-367542P 20160727

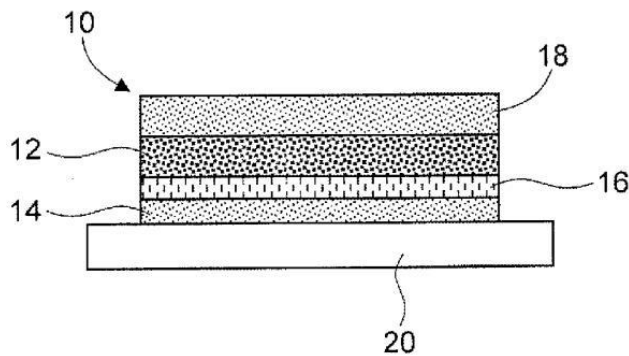
国際特許分類 発行時 INT. PATENT CLASSIF.:  
 IPC ORIGINAL: A61K0031-00 [I, A]; A61K0031-045 [N, A]; A61K0031-13 [I, A];  
 A61K0031-13 [I, A]; A61K0031-137 [I, A]; A61K0031-137 [I, A];  
 ; A61K0031-145 [I, A]; A61K0031-18 [I, A]; A61K0031-18  
 [I, A]; A61K0031-19 [I, A]; A61K0031-192 [I, A];  
 A61K0031-192 [I, A]; A61K0031-196 [I, A]; A61K0031-196  
 [I, A]; A61K0031-216 [I, A]; A61K0031-27 [I, A]; A61K0031-27  
 [I, A]; A61K0031-381 [I, A]; A61K0031-4045 [I, A];  
 ;

共通特許分類 CPC: A61K0031-00; A61K0031-045; A61K0031-13; A61K0031-137;  
 A61K0031-18; A61K0031-192; A61K0031-196; A61K0031-216;  
 A61K0031-27; A61K0031-381; A61K0031-4045; A61K0031-439;  
 A61K0031-445; A61K0031-4458; A61K0031-4468; A61K0047-02;  
 ;

米国特許分類 FI USCLASS NCLM: 001/001.000  
 JAP. PATENT CLASSIF.:  
 MAIN: A61K0009-70 401; A61K0031-445  
 SECONDARY: A61K0031-13; A61K0031-137; A61K0031-18; A61K0031-19;  
 A61K0031-192; A61K0031-196; A61K0031-27; A61K0031-445;  
 A61K0031-663; A61K0047-02; A61K0047-10; A61K0047-12;  
 ;

F ターム FTERM CLASSIF.: 4C076; 4C086; 4C206; 4C086/AA01; 4C206/AA01; 4C086/AA02;  
 4C206/AA02; 4C076/AA72; 4C076/AA74; 4C076/AA81;  
 4C076/BB31; 4C086/BC21; 4C076/CC01; 4C086/DA02;  
 4C206/DA22; 4C206/DA25; 4C206/DA30; 4C086/DA34;  
 4C076/DD25; 4C076/DD26; 4C076/DD37; 4C076/DD38;  
 ;

図面 GRAPHIC IMAGE:



抄録 BASIC ABSTRACT:  
 US 20180028462 A1 UPAB 20180222  
 NOVELTY - A transdermal delivery system comprises a skin contact adhesive layer (14) for attaching to skin of user, and a drug reservoir (12) comprising acrylate copolymer, glycerin and donepezil base generated in-situ by reaction of donepezil hydrochloride and alkaline salt.  
 DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are included for a composition comprising drug reservoir which contains donepezil base, glycerin, and acrylic acid/vinyl acetate copolymer; or drug reservoir which contains donepezil base, solvent comprising triethyl citrate, lauryl lactate, sorbitan monolaurate and/or glycerin, and crosslinked polyvinylpyrrolidone and acrylic acid/vinyl acetate copolymer.  
 ACTIVITY - Neuroprotective; Nootropic. Test details are described but no results given.  
 MECHANISM OF ACTION - Acetylcholinesterase Inhibitor.

USE - Transdermal delivery system for administering donepezil base used for treating Alzheimer's disease in subject (claimed).

ADVANTAGE - The system achieves transdermal delivery of therapeutic agent at steady state that is bioequivalent to oral administration of therapeutic agent.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows a sectional view of transdermal delivery system.

Drug reservoir (12)  
Skin contact adhesive layer (14)  
Microporous membrane (16)  
Backing layer (18)  
Release liner (20)

Technology Focus **TECHNOLOGY FOCUS:**

INORGANIC CHEMISTRY - Preferred Components: The alkaline salt in the drug reservoir layer is sodium carbonate, potassium carbonate, trisodium phosphate, disodium hydrogen phosphate, or preferably sodium bicarbonate.

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Components: The intermediate layer is a microporous membrane (16). The pores in microporous membrane contain solvent composition comprising triethyl citrate, sorbitan monolaurate, and/or lauryl lactate. The drug reservoir layer further comprises triethyl citrate and sorbitan monolaurate and/or lauryl lactate. The alkaline salt may be sodium oxalate, sodium succinate, sodium citrate, and sodium salicylate.

PHARMACEUTICALS - Preferred Components: The delivery system further comprises an intermediate layer disposed between contact adhesive layer and drug reservoir, a first backing layer in contact with the drug reservoir layer, an adhesive overlay in contact with the first backing layer, and a second backing layer in contact with the adhesive overlay.

拡張抄録 **EXTENSION ABSTRACT:**

ADMINISTRATION - The transdermal delivery system is administered once weekly and provides donepezil base at 1-25 mg/24 hours (claimed).

EXAMPLE - 1.20 g Sorbitan monolaurate was dissolved in 6 g triethyl citrate and mixed with 1.80 g lauryl lactate and 89.69 g ethyl acetate. 6 g Glycerin was added and mixed. 9 g Donepezil hydrochloride and 1.82 g sodium bicarbonate were added and dispersed in the mixture. 12 g Crosslinked micronized polyvinylpyrrolidone was added and the mixture was homogenized. 43.93 g Acrylic acid/vinyl acetate copolymer was added and mixed. The wet adhesive formulation was coated on release liner and dried to yield dry coating weight of 12 mg/cm<sup>2</sup> to obtain drug reservoir. 0.60 g Sorbitan monolaurate was dissolved in 3 g triethyl citrate and mixed with 0.9 g lauryl lactate, 25.45 g ethyl acetate and 1.34 g isopropanol. 6 g Crosslinked, micronized polyvinylpyrrolidone was added and the mixture was homogenized. 38.61 g Acrylic acid/vinyl acetate copolymer was added and mixed. The wet adhesive formulation was coated on a release liner and dried to obtain dry coating weight of 5 mg/cm<sup>2</sup> to obtain contact adhesive. A rate controlling membrane was laminated on adhesive side of drug reservoir. The contact adhesive was laminated on top of rate controlling membrane. The release liner on drug reservoir side was replaced and laminated with backing film. The final five layer laminate was die-cut into transdermal patches.

ファイルセグメント **FILE SEGMENT: CPI**

マニュアルコード **MANUAL CODE: CPI: A04-D05A; A04-F04B; A04-F06E5; A04-F09; A12-V01; B04-C03; B05-A01A; B05-A01B; B05-B02A3; B07-A02A; B07-D05; B10-C02; B10-C03; B10-E04C; B10-G02; B12-M02D; B12-M02F; B14-D07A; B14-J01A4**

## MEMB 形式での表示

Member (0001)

特許情報 PI US 20180028462 A1 20180201 (201812) \* EN 24[5]  
 英語標題 TIEN DONEPEZIL TRANSDERMAL DELIVERY SYSTEM  
 発明者名 IN LEE E S  
 INO: Lee, Eun Soo  
 INA: Redwood City, CA, US  
 JAIN A K  
 INO: Jain, Amit K.  
 INA: Milpitas, CA, US  
 SINGH P  
 INO: Singh, Parminder  
 INA: Union City, CA, US

特許出願人 PA (CORI-N) CORIUM INT INC  
 PAO: CORIUM INTERNATIONAL, INC.  
 PAA: Menlo Park, CA, US  
 Residence: US  
 Nationality: US

出願情報の詳細 ADT US 20180028462 A1 Provisional US 2017-504408P 20170726; US 20180028462 A1  
 Provisional US 2017-504391P 20170510; US 20180028462 A1 Provisional US  
 2017-457794P 20170510; US 20180028462 A1 Provisional US 2017-444763P  
 20170210; US 20180028462 A1 Provisional US 2017-444745P 20170110; US  
 20180028462 A1 Provisional US 2016-423133P 20170110; US 20180028462 A1  
 Provisional US 2016-367542P 20161116; US 20180028462 A1 Provisional US  
 2016-367502P 20160727; US 20180028462 A1 Provisional US 2016-367502P  
 20160727

出願情報 APTS 2017US-000660939 20170726; 2017US-000504408P 20170510; 2017US-000504391P  
 20170510; 2017US-000457794P 20170210; 2017US-000444763P 20170110;  
 2017US-000444745P 20170110; 2016US-000423133P 20161116; 2016US-000367542P  
 20160727; 2016US-000367502P 20160727

発行時の国際特許分類 IPCI Current: A61K0009-70 [I, A]  
 Original: A61K0009-70 [I, A]

共通特許分類 CPC Current: A61K0031-00; A61K0031-045; A61K0031-13; A61K0031-137;  
 A61K0031-18; A61K0031-27; A61K0031-445; A61K0047-02; A61K0047-10;  
 A61K0047-12; A61K0047-32; A61K0009-7023; A61K0009-7038; A61K0009-7053;  
 A61K0009-7061; A61K0009-7084; A61K0009-7092; C08K0005-0016  
 Original: A61K0031-445; A61K0009-7038; A61K0009-7084

米国特許分類 NCL NCLM 001/001.000  
 英語抄録 ABEN A transdermal delivery system for systemic delivery of donepezil is  
 described, where the system comprises an adhesive matrix drug reservoir  
 layer comprised of a copolymer of acrylic acid/vinyl acetate, triethyl  
 citrate, and donepezil base generated in situ by reaction of donepezil HCl  
 and an alkaline salt. The system is provided for treatment of Alzheimer's  
 disease, and achieves transdermal delivery of the therapeutic agent at  
 steady state that is bioequivalent to administration of the therapeutic  
 agent orally.

英語クレーム CLMEN [CLAIM 1] 1. A transdermal delivery system for systemic delivery of  
 donepezil, comprising: a skin contact adhesive layer to attach the system  
 to the skin of a user, and a drug reservoir comprised of (i) an acrylate  
 copolymer, (ii) glycerin, and (iii) donepezil base generated in situ by  
 reaction of donepezil HCl and an alkaline salt.  
 [CLAIM 2] 2. The system of claim 1, further comprising an intermediate  
 layer directly on the contact adhesive layer and disposed between the  
 contact adhesive layer and the drug reservoir.  
 [CLAIM 3] 3. The system of claim 2, wherein the intermediate layer is a  
 microporous membrane comprising a plurality of pores.  
 [CLAIM 4] 4. The system of claim 3, wherein the plurality of pores in the  
 microporous membrane contains a solvent composition comprised of one or  
 more of triethyl citrate, sorbitan monolaurate, and lauryl lactate.

Member (0002)

PI WO 2018022815 A3 20180308 (201818) EN  
 TIEN TRANSDERMAL FORMULATION AND DELIVERY METHOD OF LOW SOLUBILITY OR UNSTABLE  
 UNIONIZED NEUTRAL DRUGS BY IN SITU SALT-TO-NEUTRAL DRUG CONVERSION OF SALT DRUG

CITN 形式での表示 (引用情報)

AN 2018-58265Y [201854] WPIX

引用数 Citation Counters

引用特許数	PNC. D	27	Cited Patents Count
引用特許の特許発行国数	PCC. D	4	Cited Patents Country Count
引用文献数	CRC	16	Cited Literature Reference Count
引用数 (合計)	REC	43	Cited Reference Count (total)
引用特許のWPIレコード数	ANC. D	26	Cited DWPI Accession Number Count
被引用特許数	PNC. G	13	Citing Patents Count
被引用特許の特許発行国数	PCC. G	3	Citing Patents Country Count
被引用特許のWPIレコード数	ANC. G	9	Citing DWPI Accession Number Count

審査官調査フィールド EXF Examiner's Field of Search

Citing Publication EXF Examiner's Field of Search

US 10898617 B2 CPC A61L2300-404; A61L2300-42; A61L2400-18; A61L2420-02;  
 A61L0029-041; A61L0029-043; A61L0029-06;  
 A61L0029-16; A61L0031-042; A61L0031-046;  
 A61L0031-06; A61L0031-16

引用特許情報 CDP Cited Patents

Citing Publication By Cat Cited Patent Date Accession Number

US 20180207323 A1 E Y US 20050107870 A1 20050519 2005-402993  
 PA: (GREE-I) GREENWALD H J; (WANG-I) WANG X  
 IN: GREENWALD H J; WANG X  
 Relevant passages: [0059]  
 Relevant to claim: 5

E X US 20120136323 A1 20120531 2011-B93445  
 PA: (NOVA-N) NOVAN INC  
 IN: BAUMAN S; JOSHI P R; STASKO N  
 Relevant passages: abstract Fig. 1, [0117], [0137] |  
 [0059] | claim 3 | F.2d | [0063] and [0064] |  
 [0081] | [0079]-[0080] | [0088] | claim 9 | [0125]  
 | claim 13 | claim 14 | [0145] | claim 24 | claim  
 15 | [0100] and [0113] | claim 19 | [0147] | [0155]  
 | claim 22 | [0058], [0059], [0063] [0064] | para  
 [0058] | claim 5 | claim 1 | Fig. 4B Fig 5B [0138]  
 | [0141] | column 4 lines 47-51 | column 5 lines  
 7-10 | claim 18 | , abstract Fig. 1, [0117], [0137]  
 | [0059] | claim 3 | F.2d | [0063] and [0064] |  
 [0081] | [0079]-[0080] | [0088] | claim 9 | [0125]  
 | claim 13 | claim 14 | [0145] | claim 24 | claim  
 15 | [0100] and [0113] | claim 19 | [0147] | [0155]  
 | claim 22 | [0058], [0059], [0063] [0064] | para  
 [0058] | claim 5 | claim 1 | Fig. 4B Fig 5B [0138]  
 | [0141] | column 4 lines 47-51 | column 5 lines  
 7-10 | claim 18 |  
 Relevant to claim: 1-4, 6-15, 19, 22, 5, 16-18

E Y US 7750201 B2 20100706 2008-E59466  
 PA: (COVI-C) TYCO HEALTHCARE GROUP LP  
 IN: DOWD B; FINK E D; HEAGLE D G; MULLIGAN S A; ORR S;  
 PATEL H A; SHAH C B; SWANIKER H P; TRANCHEMONTAGNE  
 A; VITARIS R F; WARD K  
 Relevant passages: abstract Fig. 2 | column 5 line 53  
 column 6 line 5 | column 4 lines 47-51 | column 5  
 lines 7-10 | claim 18 | claim 19 | [0059]  
 Relevant to claim: 16-18

WO 2018136845 A1 E Y RU 2350356 C1 20090327 2009-G41921  
 PA: (CHAS-I) CHASHCHIN V A; (KHOT-I) KHOTIMSKII D V;  
 (MANA-I) MANAEVA T V; (VISH-I) VISHNYAKOV A V  
 IN: CHASHCHIN V A; KHOTIMSKII D V; MANAEVA T V;  
 VISHNYAKOV A V  
 Relevant passages: , abstract, pp.5-6, examples  
 Relevant to claim: 21  
 :

CN 110446521 A E A CN 1633313 A 20050629 2003-788029  
 PA: (LAPC-I) LAPCIKOVA M; (MACH-I) MACHOVA L; (RYPA-I)  
 RYPACEK F  
 IN: LAPCIKOVA M; MACHOVA L; RYPACEK F  
 Relevant passages: 全文  
 Relevant to claim: 1-17, 19

E A CN 1669537 A 20050921 2005-444086  
 PA: (FALO-I) FALOTICO R; (PARR-I) PARRY T J; (ZHAO-I)  
 ZHAO J Z  
 IN: FALOTICO R; PARRY T J; ZHAO J Z  
 Relevant passages: 全文  
 Relevant to claim: 1-17, 19  
 :

EP 3570927 A4 E X US 20110244001 A1 20111006 2011-M58027  
 PA: (UYSR-C) UNIV SYRACUSE  
 IN: ISHIDA K; MATHER P; ONYEJEWKE I  
 Relevant passages: claim 1, 5 ; fig. 1, 4, 6 ; para 09,  
 35, 28, 70  
 Relevant to claim: 1-5,7,14

E IX WO 2006084912 A1 20060817 2006-578124  
 PA: (NOLA-N) NOLABS AB  
 IN: PETERS T; PETERS, Tor  
 Relevant passages: claim 1 ; fig. 1B ; pp. 14, line 26,  
 pp. 15, line 15 ; pp. 21, line 15-28  
 Relevant to claim: 1-5,7,10,14|12,13,15

E X WO 2016201237 A1 20161215 2016-77058H  
 PA: (UNMI-C) UNIV MICHIGAN  
 IN: LAUTNER G; MEYERHOFF M E; SCHWENDEMAN S P  
 Relevant passages: claim 1, 2, 5, 16 ; fig. 1, 4 ; para  
 42, 43 ; para 50, 56 ; pp. 29  
 Relevant to claim: 1,4,5,8-11,14

US 10898617 B2 E US 20050107870 A1 20050519 2005-402993  
 PA: (GREE-I) GREENWALD H J; (WANG-I) WANG X  
 IN: GREENWALD H J; WANG X

E US 20120136323 A1 20120531 2011-B93445  
 PA: (NOVA-N) NOVAN INC  
 IN: BAUMAN S; JOSHI P R; STASKO N  
 :

引用文献情報 CDL Literature Citations

Citing Publication	By	Cat	Literature Reference
WO 2018136845 A1	E XY		HANDA H. ET AL. : "In vitro and in vivo study of sustained nitric oxide release coating using diazeniumdiolate-oped poly(vinyl chloride) matrix with poly(lactide-co-glycolide) additive", J MATER CHEM B MATER BIOL MED., vol. 1, no. 29, 7 August 2013 (2013-08-07), pages 3578 - 3587, XP055519460, relevantClaims[1, 2, 4-8, 10, 12, 13, 19, 20][3, 9, 11, 14-18], relevantPassages[, especially abstract, pp. 1-9, fig. 1, 2]
	E Y		HARVEY A. LIU ET AL. : "Novel Delivery System for the Bioregulatory Agent Nitric Oxide", CHEMISTRY OF MATERIALS, vol. 21, no. 21,

EP 3570927 A4 E X ELIZABETH J. BRISBOIS ET AL: "Improved Hemocompatibility of Multilumen Catheters via Nitric Oxide (NO) Release from S-Nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) Composite Filled Lumen", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, vol. 8, no. 43, 21 October 2016 (2016-10-21), US, pages 29270 - 29279, XP055748916, ISSN: 1944-8244, DOI: 10.1021/acsami.6b08707, relevantClaims[1, 4-6, 8, 14], relevantPassages[pp. 29271, col. 1, fig. 1, 3, pp. 29273, para 3.1, ] DOI: <https://doi.org/10.1021/acsami.6b08707>

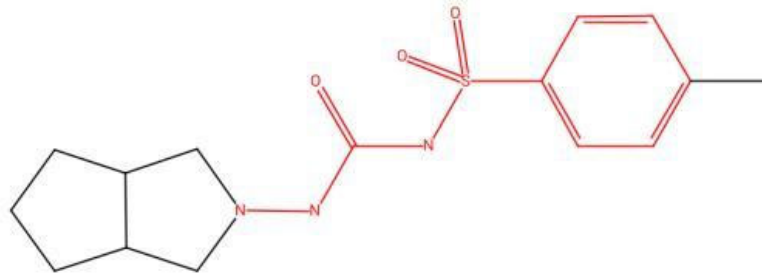
US 10898617 B2 E A See also references of WO 2018136845A1  
Yaqi Wo et al., Origin of Long-Term Storage Stability and Nitric Oxide Release Behavior of CarboSil Polymer Doped with s-Nitroso-N-acetyl-D-penicillamine, ACS Appl. Mater. Interfaces, Sep. 22, 2015, pP. 22218-22227, vol. 7.

被引用特許情報 CGP Citing Patents

Cited Publication	By	Cat	Citing Patent	Date	Accession Number
US 20180207323 A1	E	A	CN 109575246 A	20190405	2019-33484A
			PA: (UYSJ-C) UNIV SOUTHWEST JIAOTONG		
			IN: HE J; TANG P; YANG H; ZHENG X		
	E		US 20210052842 A1	20210225	2021-195944
			PA: (NOTA-N) NOTA LAB LLC		
			IN: KAHN M; MARTIN G; MEYERHOFF M E		
	E		US 20210330937 A1	20211028	2021-C0790B
			PA: (DENX-C) DENTSPLY IH AB		
			IN: ISELAU F; SOJAKKA H		
	E	XY	WO 2021040813 A1	20210304	2021-195944
			PA: (NOTA-N) NOTA LAB LLC		
			IN: KAHN M; MARTIN G; MEYERHOFF M E		
	E	Y	WO 2021040814 A1	20210304	2021-195944
			PA: (NOTA-N) NOTA LAB LLC		
			IN: KAHN M; MARTIN G; MEYERHOFF M E		
	E	A	WO 2021202709 A1	20211007	2021-B5162G
			PA: (UNMI-C) UNIV MICHIGAN		
			IN: LAUTNER G; LAUTNER-CSORBA O I; MEYERHOFF M E; MURRAY G; RAMANI K; YEVZLIN A S		
WO 2018136845 A1	E	A	CN 114206948 A	20220318	2020-C7048C
			PA: (UNMI-C) UNIV MICHIGAN		
			IN: BRISBOIS E J; DOVERSPIKE J C; KIM M; KONOPINSKA K K; LAUTNER-CSORBA O I; MACK S J; MEYERHOFF M E		
CN 110446521 A	E	A	CN 111910441 A	20201110	2020-B3763R
			PA: (NANJ-N) NANJING NUOQUAN BIOLOGICAL MEDICAL TECHN		
			IN: CAO G; CHEN T; LU Q; MAO W; QIN Y; ZHU Q		
	E	A	CN 113101053 A	20210713	2021-81605X
			PA: (USMH-C) UNIV SHANGHAI MEDICINE & HEALTH SCI		
			IN: HUANG G; YIN H		
	E	A	CN 113134116 A	20210720	2021-86345S
			PA: (SHAN-N) SHANDONG WEIGAO PHARM CO LTD		
			IN: DIAO Y; DU W; HUANG X; LIN D		
	E	A	CN 113244051 A	20210813	2021-87101X
			PA: (BECT-C) BECTON DICKINSON & CO		
			IN: LAINE B; OFEK G; QUACH C		
	E		CN 111910441 B	20211102	2020-B3763R
			PA: (NANJ-N) NANJING NUOQUAN BIOLOGICAL MEDICAL TECHN		
			IN: CAO G; CHEN T; LU Q; MAO W; QIN Y; ZHU Q		
	E		CN 113134116 B	20220906	2021-86345S
			PA: (SHAN-N) SHANDONG WEIGAO PHARM CO LTD		
			IN: DIAO Y; DU W; HUANG X; LIN D		

HITSTR 形式での表示 (DCR ファイルで構造検索し、WPI ファイルにクロスオーバーして表示)

DCR 番号 AN. S DCR-96154  
化学物質名 CN. P GLICLAZIDE  
分子式 MF C15 H21 N3 O3 S  
構造 STR



AN. S DCR-109127  
CN. P TOLAZAMIDE  
MF C14 H21 N3 O3 S  
STR

